

SEMI P10-0709

フォトマスクオーダーのデータ構造の仕様

免責事項:この SEMI スタンダードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

本スタンダードは、global Micropatterning Committee で技術的に承認されている。現版は 2009 年 5 月 13 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2009 年 6 月に www.semi.org で、そして 2009 年 7 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は 1990 年発行、前版は 2008 年 7 月に発行された。

目次

- 1 目的
- 2 範囲
- 3 制限
- 4 参照スタンダードおよび文書
- 5 用語
- 6 インストラクションおよびコンベンション
- 7 シンタックス仕様
 - 7.1 シンタックスシンボルの定義
 - 7.2 レコードシンタックス
 - 7.3 多数値データフィールドシンタックス
 - 7.4 マスクオーダー構造シンタックス (BNF)
 - 7.5 マスク結果データ構造シンタックス (BNF)
- 8 用語と用法
- 9 チェックサムを計算する
- 関連情報 1
- 関連情報 2
- 関連情報 3
- 関連情報 4
- 関連情報 5
- 関連情報 6
- 関連情報 7
- 関連情報 8
- 関連情報 9

1 目的

1.1 このデータ構造仕様は、ソフトウェアシステム間でのマスクオーダーデータの伝送を促進し、次のものを可能にする：

- マスクユーザによる自動的なオーダー入力、そしてマスク業者によるそのオーダーの自動的処理。
- マスクショップによる実際のマスク結果と品質データの自動的なオーダー、そしてマスクユーザによるそのデータの自動処理。

1.2 この標準化されたデータ構造を用いてマスクユーザまたはマスク業者のどちらかに対し、それぞれ独立に書かれたソフトウェアを他のグループによって書かれたソフトウェアと確実に通信できるようにすべきである。

2 範囲

2.1 このデータ構造は、伝送されるデータフォーマットのみを定義する。拡張マークアップ言語 (XML) フォーマットを選択するユーザーのために、XML フォーマットによる公式の実装が SEMI P10 ウェブサイトに掲載される場合を除き、このスタンダードによって特定のデータベースやプログラミング言語が指定されることはない。データファイルは UTF-8 ファイルとして伝送される。SECS-II スタンダードとの間には両立性がある。

NOTICE: This standard does not purport to address safety issues, if any, associated with its use. It is the responsibility of the users of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory or other limitations prior to use.

注意： このスタンダードはその使用に関連したすべての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダードのユーザーは、その責任において、適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し、また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。

3 制限

3.1 どのユーザに対しても、すべてのパターン・ファイルは専用のものでなければならない(すなわち、異なるパターン・ファイルが同じ名称をもつことはできない)。

3.2 どのユーザに対しても、すべてのマスク描画コントロールファイル(ジョブ・ファイル)は専用のものでなければならない(すなわち、異なるマスク描画コントロールファイルが同じ名称をもつことはできない)。

3.3 どのユーザに対しても、それぞれのマスクセットは専用の識別方法をもたなければならない。

3.4 任意のユーザに対し、それぞれの磁気テープまたはマスクショップに届けられる他の物理的メディアは専用の識別方法をもたなければならない。

3.5 任意のユーザに対し、マスクサプライヤに伝送される、それぞれの SEMI P10 <mask_order>ファイルは、専用の識別方法をもたなければならない。特に、<mask_order>ファイルの改訂は、改訂された専用の識別方法をもたなければならない。

3.6 すべての <pattern_data> , <job_data> , FRACTURE_FILE , MEASURE_FILE_NAME そして CD_MATRIX_FILE_NAME ファイルが<mask_order>内で使用されるために<data>構造を通して紹介されること。そのようなファイルが、<data>を通して同定すること無しに<mask_order>に参照される場合、そのようなファイルを同定し設定するための特定の方法及び顧客とベンダー間で確立されねばならない。

4 参照スタンダードおよび文書

4.1 SEMI スタンダード

SEMI P1 — Specification for Hard Surface Photomask Substrates

SEMI P2 — Specification for Chrome Thin Films for Hard Surface Photomasks

SEMI P4 — Specification for Round Quartz Photomask Substrates

SEMI P5 — Specification for Pellicles

SEMI P6 — Specification for Registration Marks for Photomasks

SEMI P21 — Guidelines for Precision and Accuracy Expression for Mask Writing Equipment

SEMI P22 — Guideline for Photomask Defect Classification and Size Definition

SEMI P24 — CD Metrology Procedures

SEMI P29 — Guideline for Description of Characteristics Specific to Halftone/Attenuated Phase Shift Masks and Mask Blanks

SEMI P35 — Terminology for Microlithography Metrology

SEMI P37 — Specification for Extreme Ultraviolet Lithography Mask Substrates

SEMI P38 — Specification for Absorbing Film Stacks and Multilayers on Extreme Ultraviolet Lithography Mask Blanks

SEMI P39 — Specification for Open Artwork System Interchange Standard (OASIS)

SEMI P43 — Photomask Qualification Terminology

SEMI P44 — Specification for Open Artwork System Interchange Standard (OASIS) Specific to Mask Tools

4.2 ISOスタンダード¹

ISO 4217:2001 — Currency and funds code list²

ISO 8601:2000 — Date and time notation³

ISO/IEC 10646 — UTF-8 character set⁴

NOTICE: Unless otherwise indicated, all documents cited shall be the latest published versions.

注意: 別途指示のない場合、引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。

5 用語

5.1 § 8 参照。

6 インストラクションおよびコンベンション

6.1 ファイル内のそれぞれのレコードは、特定のキーワード識別子とそれに続くデータ値で構成されている。BNF シンタックスの場合、それぞれのレコードはキャリッジリターンおよび、またはラインフィードによって終結される。

6.2 そのオーダーを指定する必要があるレコードのみが、伝送される<mask_order>ファイルの中に包含される必要があるが、包含されるそれぞれのレコードはシンタックス仕様に示される順序で発生しなければならない。

6.3 マスクセットに続く修正または追加は適応する場合には、事前に伝送されたキーワードやデータフィールドを含めて特定マスクに対するすべての情報を伝送することが必要である。新しいオーダー伝送によって影響されない事前にオーダーされたマスクは<mask_definition>、<mask_group>、または<mask_set>を省力することができる。

6.4 オプションは、もし低レベルにおいて無視にされるのであれば、高レベルで指定されたこれらのオプションが下位のすべてのマスクに対して不履行になるように階層的に指定される。階層は、マスクセットオプションがマスクグループオプションによって無視され、それに続くマスク定義、セル定義、セルの例、パターングループ定義、およびパターン定義によっても無視されるものである。マスクタイトル階層は一般的なタイトルナンバーをもつタイトルキーワードに適用する。

1 International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, 1, rue de Varembe, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. Telephone: 41.22.749.01.11; Fax: 41.22.733.34.30; <http://www.iso.ch>

2 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

3 <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-time.html>

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Character_Set

6.5 マスクグループは、同じように構成された一連のマスクについて述べている。簡単な場合においては、1つのマスクセットに対して1つのマスクグループのみが存在する。多数のマスクグループは、mix-and-match セットについて述べるために必要とされるか、または異なる特徴がいくつかのマスクに必要な場合に1つのマスクセット内の状況について述べるために必要とされる。

6.6 パターングループの定義は、マスクグループ内のすべてのまたは大抵のマスク上に同じように置かれるパターンのために考えられている(例えば、主要パターン・ファイルまたはテストパターン・ファイル)。

6.7 セルの定義は、パターングループあるいは他のセルのクラスターの構成、またはその両方の構成を述べている。マスクグループのもとにおける PLACEMENT_TOP_CELL はマスクグループ内におけるすべてのマスク上のセル全体配置を述べている。

6.8 どのマスクセット内においてもそれぞれのマスクは、マスク上のタイトルに関わらず専用の識別(MASK_ID)を持たなければならない

6.9 (位相シフトマスクのように)複数の描画工程を必要とするマスクは MULTIWRITE キーワードによって同一グループ番号とされる MASK_ID を認識する。

6.10 マスクグループのもとにおいて定義される MASK_ID は、作製されるべきマスクを指定する。マスクグループの PLACEMENT_TOP_CELL のもとにおいて引用されたパターンの LEVEL_ID に MASK_ID がマッチする場合にのみ、パターンはマスク上に置かれる。

6.11 <cell instance>および<pattern group instance>LOCATION は、CELL_ID の中心に関してパターンの中心を位置決めする。PLACEMENT_TOP_CELL によって引用されるセルは、マスクの中心に位置決めされる。

6.12 ジョブファイルデータは、セルおよびパターングループデータに代わって提供することができる。この場合に MASK_ID はジョブファイル内で使用される JOB_NAME の中の JOB_LEVEL に対応するものとして理解されている。

6.13 座標の位置に関して、他にキーワードで指定されていなければ、マスクのオプションはマスクの公称中央と二組をなし、一方セルまたはパターンオプションはセルの中心またはパターンの中心と二組をなす。マスクの座標は、スケーリングとミラーの後であるが、セルとパターンオプションはスケーリングとミラーの前である。座標と方向は描画される基板において右回りの直角座標(カーテンアン座標)を参照する。基板上に書かれたこれらすべての特徴、その他すべてのパターンの方向は、マスクの描画ツールの見地から想定したものである(クロム側を上にする、など)。マスクの公称中央は底部と左端(クロム側が上の状態)で決定され、公称基板の寸法を想定している(SEMI P1 参照)。

6.14 構造内におけるすべてのデータは UTF-8 文字セットにある。各レコード内のキーワードは、大文字の英数字の文字とアンダーラインのみを含まなければならない。

6.15 レコード(キーワード、データ値、コメントおよびニューライン)は 256 文字を超えることはできない。あるレコードでは、より長いフィールド要求を許すために繰り返し使用することができる(例えば、BUSINESS_ADDRESS)。これらはシンタックス仕様に明確に指示されている。

6.16 感嘆符(!)を先頭に置くことにより、レコード中にコメントを入れることができる。感嘆符に続くデータおよびキャリッジリターンおよびラインフィードに先立つデータは無視される。そのようなコメントは 256 文字のレコード限界内に含まれる。レコードが感嘆符で始まるときには、すべてのレコードが無視される。印刷可能/印刷不可の UTF-8 文字(およびスペースとタブ)のみをコメント内に入れることができる。コメントは開発および診断の目的のみに使用される。商用の場合には、コメントは常に周囲に影響を与えることなく受取側で無視することができる。一方、ADDITIONAL_..._INFO レコードは、受取側が評価してオーダーされているマスクに適用しなければならない。また、これによってマスク授受のディレイを整えることができる。

6.17 キーワードに先行するスペースまたはタブは無視される。少なくとも1つのスペースまたはタブがデータフィールドに先行しなければならない。テキストデータフィールド内に埋め込まれたスペースおよびタブは保存される。スペースまたはタブを整数または実数のデータ値の内部に埋め込むことはできないが、多数値の数値データフィールド内でデータ値を分離するために用いることはできる。多数値のデータフィールド内の隣接するデータ値間に

少なくとも 1 つのコンマがなければならない。隣接するデータ値間には 1 つ以上のコンマを入れることはできない。データフィールド内の最後のデータ値に続くスペースまたはタブは無視される。

6.18 単位を必要とするすべての数値レコードの値は、添付された「§ 8 の用語の定義」に別途指定されない限り国際単位系による。他に指定のない限り長さまたは位置の単位はマイクロメートルとする。

6.19 日付は YYYY-MM-DD の数値形式で表示される。時間は HH:MM:SSZ または HH:MMZ の形式で表示される。伝送されるデータファイル内の時間と日付は必ず協定世界時 (UTC) とし、時間には Z の添字をする。

6.20 CD_DATA から CD_TARGET を達成するためのサイジングは、CD_TARGET レコードによって階層的に影響を受けるすべてのパターン・ファイルに適用されなければならない。

6.21 二進データ操作は、中心と中心とを合わせるためにオペランド (入力パターン・ファイル) を必要とする。このため、ファイル範囲の明確なレコードを含まないパターンに対して、DATA_PATTERN_WINDOW が定義される必要がある。

6.22 水平 (または“x”) および垂直 (または“y”) へのすべての参照は、通常の直角座標 (カーテシアン座標) に対応し、そのマスクが描画された基板の回転方向を仮定する。

6.23 すべての<shippable_data>キーワードは透過データの透過率の方向と方式の両方あるいは何れかを規定する<ship_to>を伴う。当てはまる場合、常に SEMI <mask_results> ファイル (§ 7.5 参照) は電子透過率が規定された場合にそれに応じて送られることになる。

6.24 特定のマスク特徴場所を照合することを求める<shippable_data> キーワードは、任意の MASK_SET_ID にとって、<mask_order> のすべての透過率内で、各部分にとって専用のものでなければならない CD_SITE_ID と REGISTR_MARK_ID の両方あるいはどちらかを照合する。

6.25 バロットサイクルの谷間に本スタンダードの改訂が必要となった場合 (例えば、新たなデータフィールド値 “on request”) は、使用者は直接 N.A. (北米) SEMI P10 改訂タスクフォースリーダーと連絡をとること。タスクフォースの活動メンバー間で協議した後、暫定的な解決策が SEMI P10 改訂タスクフォースのウェブサイトに掲載されることによって、正規のバロットによって当該の課題が正式に解決されるまでの間、すべての使用者が共通の仮解決策をとることが可能になる。

6.26 SEMI P10 のファイルを不整合や不明瞭さが無いものにするために、あらゆる努力がはられること。もし顧客からのファイルにそのような不備をベンダーが見つけた場合は、ベンダーは顧客に連絡して、不整合を修正し、更に、もしくはマスク製造を進行する前に不明瞭を取り除くこと。

6.27 データの値は、整数 (integer)、数値 (numeric)、テキスト (text)、ブーリアン (Boolean)、日付 (date) (時間の有る場合と無い場合の両方) の場合がある。データフィールドには、1 種類以上のデータを含むものもある。“テキスト”は、キャリッジリターン (復帰改行)、タブまたは改行を除く印刷可能/印刷不可の UTF-8 文字となるよう検討されるべきである。テキストデータは、xsd シンタックスにおいて“列 (string)”に対応する。ブーリアンデータは、“T”または“F”の値のみである。

7 シンタックス仕様

下記はマスクオーダー入力構造に対するシンタックスを指定するものである。レコード順序は特定されており、レコードは下記の順序で現れなければならない。個々のレコードの用語それらに許される値は「§ 8 の用語の定義」に従って指定される。

7.1 シンタックスシンボルの定義 (Syntax Symbol Definition) — < > 内に示される小文字のシンタックス名は、レコードの集合体を引用するために使用される。レコードまたはレコードの集合体に { } を使用することは、レコードを任意の数繰り返すことを意味する。レコードまたはレコードの集合体に [] を使用することは、その集合体が任意であることを意味する。

7.2 レコードシンタックス (Record Syntax) — キーワードの次には任意コメントが後に続く英数字データフィールドがくる。レコードはキャリッジリターンあるいはラインフィード、またはその両方で中断する。これらの要素はそれぞれスペースまたはタブの任意の組合せに先行することができ、その場合にはこの組合せは無視される。レコード内の最初のデータ値に先行して少なくとも 1 つのスペースまたはタブが必要である。感嘆符 (!) はコメントを開始さ

せるのに必要である。感嘆符、キャリッジリターンおよびラインフィードをキーワードデータ値またはコメント内に入れることは許されない。コメントのみでもレコードを構成できることに注意する。個々のレコードに対するシンタックスは次のように定義されている。

```
<record> = [{<separator>} <keyword>
<separator> {<separator>} <data_field>}
[ {<separator>} !<comment>}
{<separator>} <new_line>
```

“separator”がスペースまたはタブである場合には、“comment”は印刷可能な ASCII 文字(およびスペースとタブ)の任意の列であり、また“new_line”はキャリッジリターン、ラインフィードまたはそれらの両方である。

7.3 多数値データフィールドシンタックス (Multi-value Data Field Syntax) — 数値データフィールドが、(x, y) のペアまたは (x1, y1, x2, y2) のダブルペア (§ 8 の用語の定義を参照) といった 1 つ以上のデータ値から成る場合、個々の値をカンマおよびスペースまたはタブの任意の組合せによって分離しなければならない。それぞれのデータ値間に 1 つのコンマが必要であるが、2 つ以上のカンマを付けてはならない。間にデータ値が入らないで、二つのコンマを付けることは許されない。

```
(x,y) = data_value {separator} comma {separator} data_value
(x,y,z) = (x,y) {separator} comma {separator} (z)
(x1,y1,x2,y2) = (x1,y1) {separator} comma {separator} (x2,y2)
(x,y,x1,y1,x2,y2) = (x,y) {separator} comma {separator} (x1,y1,x2,y2)
```

データ操作のためにのみ、セミコロンによって層とデータタイプを区別し、ダッシュは層の範囲あるいはデータタイプの範囲を示すことになる。

layer1;datatype6 , layer3-layer4,datatype1-datatype9

7.4 マスクオーダー構造シンタックス^{*} (Mask Order Structure Syntax) — 下記のシンタックス定義は、マスクオーダー構造内において対応するデータレコードに許容される適用例を表すために大文字を使用している。

Start_bnf	maskOrder	(日本語統一項目名称) マスクオーダー
<mask_order> =	START_ORDER SEMI_REVISION CUSTOMER VENDOR	START_ORDER SEMI REVISION 発注元 作製先
	FILE_DATE_TIME [OPERATOR_NAME]	仕様書発行日時 [入力者名]
	<mask_set> END_ORDER CHECKSUM	<mask_set> END_ORDER チェックサム
<mask_set> =	MASK_SET_ID <mask_set_options> END_MASK_SET_OPTIONS	マスクセット ID <mask_set_options> END_MASK_SET_OPTIONS
	{<mask_group>} END_MASK_SET	{<mask_group>} END_MASK_SET
<mask_set_options> =	[BUSINESS_CONTACT] {BUSINESS_ADDRESS} {BUSINESS_PHONE}	[購買担当者名] {購買担当者住所} {購買担当者 電話番号}
	{BUSINESS_FAX} [BUSINESS_EMAIL]	{購買担当者 FAX 番号} [購買担当者 E- MAIL アドレス]

^{*} シンタックスの「日本語統一名称」欄(最右列)は、独立行政法人産業技術総合研究所と株式会社先端 SoC 基板技術開発が実施した「最先端システムオンチップ設計製造技術に関する研究」の成果を使用している。

[BILLING_CONTACT] {BILLING_ADDRESS}	[経理担当者名] {経理担当者住所}
{BILLING_PHONE} {BILLING_FAX}	{経理担当者電話番号} {経理担当者 FAX 番号}
[BILLING_EMAIL]	{経理担当者 E-MAIL アドレス}
[DESIGN_RULE] [FAB_TECHNOLOGY]	[設計ルール] [ファブ・テクノロジー] [ウェハ工場]
[WAFER_FAB]	
{CUSTOMER_SPEC CUSTOMER_SPEC_REVISION}	[顧客共通仕様書 顧客共通仕様書 REVISION]
{WAIVER} {WAIVER_OVERRIDE}	{規格免除} {規格免除不可}
[PRICE_UNITS]	[通貨単位]
{MASK_EXPORT_NUMBER} [SECURITY_CLASS]	{マスクエクスポート番号} [機密区分] [QS9000]
[QS9000]	
[ENGINEERING_CONTACT] {ENGINEERING ADDRESS} {ENGINEERING_PHONE}	[設計担当者名] {設計担当者住所} {設計担当 者電話番号}
{ENGINEERING_FAX} [ENGINEERING_EMAIL]	{設計担当者 FAX 番号} [設計担当者 E- MAIL アドレス]
[SHIPPING_CONTACT] {SHIPPING_ADDRESS}	[納入先担当者名] {納入先担当者住所} {納入 先担当者電話番号}
{SHIPPING_PHONE}	
{SHIPPING_FAX} [SHIPPING_EMAIL]	{納入先担当者 FAX 番号} [納入先担当者 E- MAIL アドレス]
{SHIPPING_METHOD}	{マスク納入方法}
[REPAIRS_AUTHORIZED]	[欠陥修正承認省略]
[<shippable_data>]	[<shippable_data>]
{<data>}	{<data>}
{<standard_pattern>}	{<standard_pattern>}
[MILESTONES <ship_to>] [PERIODIC_UPDATES <ship_to>]	[進捗報告 (完了工程単位)] [進捗報告 (一定時 間単位)]
[ESTIMATED_ARRIVALS <ship_to>]	[納入予定日時]
[JOB_ONLY_APPROVAL_REQD]	[JOB_ONLY_APPROVAL_REQD]
[JOB_WITH_PATTERNS_APPROVAL_REQD]	[JOB_WITH_PATTERNS_APPROVAL_RE QD]
{PATTERN_APPROVAL_REQD}	{PATTERN_APPROVAL_REQD}
[ALL_PATTERNS_APPROVAL_REQD]	[ALL_PATTERNS_APPROVAL_REQD]
{APPROVAL_REQD}{REVIEW_REQD}	{マスク描画前承認必要項目}{確認項目}
[MASK_SET_NAME [MASK_SET_VERSION]]	[マスクセット名 [マスクセットバージョン]] [顧客用 マスクセット名]
[CUSTOMER_MASK_SET_NAME]	
[MASK_SET_NAME [MASK_SET_VERSION]]	[マスクセット名 [マスクセットバージョン]]
[ORDER_ID]	[注文 ID]
{ DEVICE_NAME [DEVICE_REVISION] }	{ DEVICE_NAME [DEVICE_REVISION] }
{ADDITIONAL_MASK_SET_INFO}	{マスクセット追加情報}
DATA_MEDIUM [DATA_LOCATION]	データ支給形態 [データ保管場所] [データファイ ル名] [データ ID]
[DATA_FILE_NAME] [DATA_ID]	
[DATA_FORMAT [DXF_ANGLE DXF_UNIT]]	[データフォーマット [DXF アンクル DXF ユニッ ト]]
[DATA_DENSITY] [DATA_FILE_SIZE]	[データ記録密度] [データファイルサイズ]
[TRANSFER_FILE_NAME [DATA_COMPRESSION]	[転送ファイル名] [データ圧縮アルゴリズム] [デ ータアーカイブフォーマット] [データ暗号化アル ゴリズム]
[DATA_CONSOLIDATION] [DATA_ENCRYPTION]	

<data> =

[DATA_CHECKSUM DATA_CHECKSUM_TYPE]	[データチェックサム データチェックサムタイプ]
<pattern_data> {<job_data>}	{<pattern_data>} {<job_data>}
{ FRACTURE_FILE FRACTURE_FILE_FORMAT}	[フラクチャファイル名 フラクチャファイルフォーマット]
{MEASURE_FILE_NAME [MEASURE_FILE_FORMAT]}	{位置測定ファイル名 [位置測定ファイルフォーマット]}
{CD_MATRIX_FILE_NAME [CD_MATRIX_FILE_FORMAT]}	{CD 測定ファイル名 [CD 測定ファイルフォーマット]}
END_DATA_MEDIUM	END_DATA_MEDIUM
<pattern_data> = DATA_PATTERN_NAME [FILE_IDENTIFIER] <pattern_attributes>	パターンデータ名 [ファイル識別子] <pattern_attributes>
{PATTERN_FORMAT} [DATA_FILE_NUMBER]	{パターンフォーマット} [データファイル番号]
[PATTERN_UNITS] [PATTERN_CHARACTER_SET]	[パターンファイル単位系] [パターンキャラクタセット]
[FRACTURE_FILE]	[フラクチャファイル名]
{ [<data_manipulation>] [<data_function>] }	{ [<data_manipulation>] [<data_function>] }
END_DATA_PATTERN_NAME	END_DATA_PATTERN_NAME
<pattern_attributes> = [UNSCALED_PATTERN_SIZE] [PATTERN_ADDRESS_SIZE] [STRIPE_HEIGHT]	[パターンサイズ (スケール前)] [パターンアドレスサイズ] [ストライプハイト]
[DIGITIZED_DATA_DARK] [MFG_BIAS_PREAPPLIED] [PERCENT_CLEAR]	[マスクトーン] [マスクプロセスバイアス] [マスク開口率]
[PATTERN_VISUAL_ID]	[パターン内印字の確認要否]
<data_manipulation> = START_DATA_MANIPULATION	START_DATA_MANIPULATION
[BOOLEAN]	[論理演算]
[PATTERN_GENERATION_AREA]	[パターン発生領域]
<data_file_parameters> { <data_file_parameters> }	<data_file_parameters> { <data_file_parameters> }
{<data_fracture>}	{<data_fracture>}
END_DATA_MANIPULATION	END_DATA_MANIPULATION
<data_file_parameters> = DATA_SOURCE_FILE [PATTERN_FORMAT]	データソースファイル名 [パターンフォーマット]
[DATA_TOP_CELL] [DATA_LAYER_ID]	[データトップセル名] [論理演算層]
[DATA_PATTERN_WINDOW]	[パターン領域]
{<data_fracture>}	{<data_fracture>}
END_DATA_SOURCE_FILE	END_DATA_SOURCE_FILE
<data_function> = START_DATA_FUNCTION	START_DATA_FUNCTION
DATA_FUNCTION_PURPOSE	ソフトウェア処理依頼
{ SOFTWARE_NAME {SOFTWARE_REVISION}	{ソフトウェアプログラム名 {ソフトウェアプログラム REVISION}
{ RUNSET_NAME [RUNSET_REVISION] [DATA_LOCATION]	{ランセット名 [ランセット REVISION] [データ保管場所]
{ PARAMETER_FILE_NAME [PARAMETER_FILE_REVISION]}	{パラメータファイル名 [パラメータファイル REVISION]}
{ INPUT_FILE_NAME INPUT_FILE_FORMAT	{入力ファイル名 入力ファイルフォーマット

	[TOP_CELL] [DATA_LOCATION] }	[トップセル名] [データ保管場所] }
	{RESULT_FILE_NAME} {SUMMARY_FILE_NAME} {LOG_FILE_NAME} } }	{出力ファイル名} {サマリーファイル名} {ログ ファイル名} } }
	END_DATA_FUNCTION	END_DATA_FUNCTION
<data_fracture> =	START_DATA_FRACTURE	START_DATA_FRACTURE
	[SIZING [SIZING_RULE] [SIZING_BORDER_RULE]]	[マスクデータリサイズ [コーナー部リサイズ方法 境界部リサイズ方法]]
	[FRACTURING_SCALE] [DATA_SCALE_FACTOR]	[フラクチャリング倍率] [データ変換倍率]
	[PATTERN_ADDRESS_SIZE]	[データアドレスユニット]
	[DARK_INTERNAL_WINDOW] [CLEAR_INTERNAL_WINDOW]	[黒ベタ発生領域] [白ベタ発生領域]
	[EXTERNAL_WINDOW] [ROTATION] [MIRROR]	[データ切出し領域] [回転指示] [ミラー反転指示]
	END_DATA_FRACTURE	END_DATA_FRACTURE
<job_data> =	DATA_JOB_NAME JOB_FORMAT	支給ジョブ名 支給ジョブフォーマット
<standard_pattern> =	STD_PATTERN_NAME PATTERN_FORMAT	支給済みパターン名 パターンフォーマット
<mask_group> =	MASK_GROUP_ID [<mask_options>] END_MASK_GROUP_OPTIONS	マスクグループID [<mask_options>] END_MASK_GROUP_OPTIONS
	PLACEMENT_TOP_CELL {<mask_definition>}	トップセル配置名 {<mask_definition>}
	{<cell_definition>} {<pattern_group>} END_MASK_GROUP	{<cell_definition>} {<pattern_group>} END_MASK_GROUP
<mask_options> =	[BLANKET_PO_NUMBER] [PO_NUMBER] [SO_NUMBER] [ORDER_ID]	[包括注文番号] [注文番号] [受注番号] [注文 ID]
	[RELEASE_NUMBER] [LINE_ITEM_NUMBER] [QUOTE_NUMBER]	[包括注文番号リリース番号] [品目番号] [見積り 書番号]
	[STATUS]	[製作指示]
	[DUE_DATE_TIME_REQUESTED] [DUE_DATE_TIME_COMMITTED]	[要求納期日時] [DUE_DATE_TIME_COMMITTED]
	[DELIVERY_PRIORITY]	[納入優先度]
	[LAYER_PRIORITY [ELAPSED_TIME]]	[作製順 [納入スケジュール]]
	[MILESTONES <ship_to>] [PERIODIC_UPDATES <ship_to>]	[進捗報告 (完了工程単位)] [進捗報告 (一定時 間単位)]
	[ESTIMATED_ARRIVALS <ship_to>]	[納入予定日時]
	[BUSINESS_CONTACT] {BUSINESS_ADDRESS} {BUSINESS_PHONE}	[購買担当者名] {購買担当者住所} {購買担当 者電話番号}
	{BUSINESS_FAX} [BUSINESS_EMAIL]	{購買担当者 FAX 番号} [購買担当者 E- MAIL アドレス]
	[BILLING_CONTACT] {BILLING_ADDRESS}	[経理担当者名] {経理担当者住所}
	{BILLING_PHONE} {BILLING_FAX} [BILLING_EMAIL]	{経理担当者電話番号} {経理担当者 FAX 番 号} [経理担当者 E-MAIL アドレス]
	[PRICE]	[価格]
	{PTC_HOURS [PTC_RATE] [PTC_FIXED] }	{PTC_HOURS [PTC_RATE] [PTC_FIXED] }
	[EWT_THRESHOLD EWT_RATE [EWT_CEILING]]	[EWT_THRESHOLD EWT_RATE [EWT_CEILING]]
	[SECURITY_CLASS] [QS9000]	[機密区分] [QS9000]

[SHIPPING_CONTACT] {SHIPPING_ADDRESS} {SHIPPING_PHONE}	[納入先担当者名] {納入先担当者住所} {納入先 担当者電話番号}
{SHIPPING FAX} [SHIPPING_EMAIL]	{納入先担当者 FAX 番号} [納入先担当者 E- MAIL アドレス]
{SHIPPING_METHOD}	{マスク納入方法}
[REPAIRS_AUTHORIZED]	[欠陥修正承認省略]
[<shippable_data>]	[<shippable_data>]
{MFG_SITE_REQD}	{作製工場指定}
{[LITHO_EQUIP_REQD] {EQUIP_SITE_REQD}	{[マスク描画方式指定] {装置指定}
{[LITHO_MODEL_REQD] {LITHO_MODE_REQD}}}	{[描画装置] {描画モード}}}
PRODUCT_TYPE [SERVICE_TYPE] [PRODUCT_MAGNIFICATION] [PRODUCT_IMAGING_TYPE]	マスク区分 [サービスタイプ] [マスク倍率] [マスク 種別]
[QUANTITY] [PRODUCT_AS_DUPLICATE]	[数量] [PRODUCT_AS_DUPLICATE]
[MULTIWRITE]	[製版回数]
{WAFER_EXPOSURE_TOOL}	{アライナー識別子}
[<wafer_exposure_data> <aerial_image_data>]	[<wafer_exposure_data> <aerial_image_data>]
[FAB_TECHNOLOGY] [WAFER_FAB]	[ファブ・テクノロジー] [ウェハ工場]
[MFG_BIAS_PREAPPLIED]	[マスクプロセスバイアス]
[JOB_NAME] [JOB_LEVEL]	[ジョブ名] [ジョブレベル]
[RETROFIT_JOB_NAME] [RETROFIT_JOB_LEVEL]	[-(日本語項目名称定義せず)] [-(日本語項目名 称定義せず)]
[RETROFIT_MASK_SET_ID] [RETROFIT_MASK_ID]	[-(日本語項目名称定義せず)] [-(日本語項目名 称定義せず)]
[RETROFIT_MASK_SET_NAME RETROFIT_MASK_SET_VERSION]	[-(日本語項目名称定義せず)] [-(日本語項目名 称定義せず)]
[RETROFIT_MASK_NAME]	[-(日本語項目名称定義せず)]
{<title_data>}	{<title_data>}
{<barcode_data>}	{<barcode_data>}
[JOB_ONLY_APPROVAL_REQD] [JOB_WITH_PATTERNS_APPROVAL_REQD]	[JOB_ONLY_APPROVAL_REQD] [JOB_WITH_PATTERNS_APPROVAL_RE QD]
{PATTERN_APPROVAL_REQD} [ALL_PATTERNS_APPROVAL_REQD]	{PATTERN_APPROVAL_REQD} [ALL_PATTERNS_APPROVAL_REQD]
{APPROVAL_REQD}{REVIEW_REQD}	{マスク描画前承認必要項目}{確認項目}
[SERIAL_NUMBER]	[マスクロット番号]
[MIRROR_MASK] [MASK_ROTATION]	[マスクミラー処理] [マスク回転]
<substrate>	<substrate>
[<phase_shift>]	[<phase_shift>]
[UT1X_UNCUT] [PROCESS] [PROCESS_ETCHING_TYPE]	[UT1X マスク出荷時切断省略] [プロセス名] [エ ッチングプロセスタイプ]
[CUSTOMER_SPEC CUSTOMER_SPEC_REVISION]	[顧客共通仕様書 顧客共通仕様書 REVISION]
{WAIVER} {WAIVER_OVERRIDE}	{規格免除} {規格免除不可}

{TOP_PELLCLE_TYPE [TOP_PELLCLE_CENTRALITY_ERROR] [PRICE] }	{パターン面ベリクルタイプ [貼付けセントラリティエラー (パターン面)] [価格] }
{BOTTOM_PELLCLE_TYPE [BOTTOM_PELLCLE_CENTRALITY_ERROR] [PRICE]}	{ガラス面ベリクルタイプ [貼付けセントラリティエラー (ガラス面)] [価格]}
[GUIDES_REQD [PRICE]]	[ガイド要否 [価格]]
[CENTRALITY]	[パターンセントラリティ]
{<registration>}	{<registration>}
[REGISTR_CLOSURE [REGISTR_CLOSURE_REFERENCE_ONLY]	[クロージャ [クロージャ合否判定省略]
{REGISTR_CLOSURE_EQUIP_REQD} {EQUIP_SITE_REQD}	{クロージャ測定装置} {装置指定}
[REGISTR_CLOSURE_BEGIN REGISTR_CLOSURE_END]]	[クロージャ測定マーク(開始) クロージャ測定マーク(終了)]
[BUTTING_ERROR [BUTTING_ERROR_METHOD]]	[バッティングエラー [バッティングエラー測定方式]]
{<cd_group>}	{<cd_group>}
{<cd_set>}	{<cd_set>}
{<cd_xy_definition>}	{<cd_xy_definition>}
{<cd_clear_dark_definition>}	{<cd_clear_dark_definition>}
{<cd_same_tone_definition>}	{<cd_same_tone_definition>}
[MIN_MASK_FEATURE_SIZE] [MIN_CORNER_TO_CORNER_GAP]	[最小マスクパターン寸法] [最小マスクコーナー間ギャップ]
[MULTI_LAYER_MASK]	[マルチレイヤーマスク]
[PERCENT_CLEAR [PERCENT_CLEAR_WINDOW]]	[マスク開口率] [マスクウィンドウ開口率]
{<opc_definition>}	{<opc_definition>}
{<defect_definition>}	{<defect_definition>}
[INSPECTION_REF_LOCATION]	[欠陥検査リファレンスマーク配置座標]
{<surface_definition>}	{<surface_definition>}
[INSPECT_THROUGH_PELLCLE <defect_definition>]	[INSPECT_THROUGH_PELLCLE <defect_definition>]
{<contamination>}	{<contamination>}
{<sem_photo>}	{<sem_photo>}
[QUALITY_GROUP_ID]	[品質グレード ID]
[COMPACT_LABEL]	[納入ケースラベル]
{PACKAGE [MAX_MASKS_IN_PACKAGE] }	{納入ケース [最大収納枚数] }
{ADDITIONAL_MASK_INFO}	{マスク追加情報}
<wafer_exposure_data > =	START_WAFER_EXPOSURE_DATA
WAFER_EXPOSURE_WAVELENGTH	WAFER_EXPOSURE_WAVELENGTH
WAFER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE	WAFER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE
[WAFER_EXPOSURE_SIGMA]	[WAFER_EXPOSURE_SIGMA]
[WAFER_EXPOSURE_SIGMA_INNER WAFER_EXPOSURE_SIGMA_OUTER]	[WAFER_EXPOSURE_SIGMA_INNER WAFER_EXPOSURE_SIGMA_OUTER]

	WAFER_EXPOSURE_ILLUMINATION [POLARIZATION] END_WAFER_EXPOSURE_DATA	WAFER_EXPOSURE_ILLUMINATION [POLARIZATION] END_WAFER_EXPOSURE_DATA
<aerial_image_data> =	START_AERIAL_IMAGE_DATA AIM_WAVELENGTH [AIM_INTENSITY_VARIATION_DELTA] [AIM_FLUX_INTENSITY_DELTA] [AIM_CD_DELTA] END_AERIAL_IMAGE_DATA	START_AERIAL_IMAGE_DATA AIM_WAVELENGTH [AIM_INTENSITY_VARIATION_DELTA] [AIM_FLUX_INTENSITY_DELTA] [AIM_CD_DELTA] END_AERIAL_IMAGE_DATA
<title_data> =	START_TITLE [TITLE_TEXT] [TITLE_TYPE] [TITLE_FONT] [TITLE_HEIGHT] [TITLE_WIDTH] [TITLE_CHARACTER_SPACING] [TITLE_MAG] [TITLE_JUSTIFICATION] [TITLE_LOCATION] [MIRROR_TITLE] [ROTATE_TITLE] [ROTATE_TITLE_CHARACTERS] END_TITLE	START_TITLE [タイトルテキスト] [タイトル分類] [タイトルフォント] [タイトル文字高さ] [タイトル文字幅] [タイトル文字スペース] [タイトル描画倍率] [タイトル文字配置] [タイトル 印字位置] [タイトルミラー処理] [タイトル回転角度] [タイトル文字の回転角度] END_TITLE
<barcode_data> =	START_BARCODE [BARCODE_TYPE] [BARCODE_TEXT [BARCODE_TEXT_REFERNECE_ONLY]] [BARCODE_LOCATION] [BARCODE_ROTATION] END_BARCODE	START_BARCODE [バーコード形式] [バーコードテキスト [バーコードテキス(参照 用)]] [バーコード印字位置] [バーコード回転角度] END_BARCODE
<substrate> =	START_SUBSTRATE [BLANK_SIZE] [BLANK_TYPE] [BLANK_GRADE] [BLANK_FLATNESS] [MASK_COATING] [RESIST_TYPE] [RESIST_THICKNESS] [BLANK_BIREFRINGENCE_REQD] [ATTENUATOR] [COATING_GRADE] [MINIMUM_COATING_OPTICAL_DENSITY] [MINIMUM_BINARY_TRANSMITTANCE] [BLANK_LOT_REQD] [<euvs_blank_type>] END_SUBSTRATE	START_SUBSTRATE [ブランクサイズ] [ブランク基板材質] [ブランク クスグレード] [ブランク平坦度] [膜種] [レジストタイプ] [レジスト膜厚] [ブランク複屈折量] [ハーフトーン膜種] [遮光膜グレード] [遮光膜光学密度最小値] [BINARY 透過率最小値] [ブランクスロット(必須項目)] [<euvs_blank_type>] END_SUBSTRATE
<euvs_blank_type> =	START_EUV_BLANK_TYPE EUV_BLANK_TYPE EUV_FLATNESS_FRONT EUV_FLATNESS_BACK EUV_MULTILAYER_COMPOSITION EUV_CAPPING_COMPOSITION EUV_MMR_WAVELENGTH EUV_MEAN_PEAK_REFLECTIVITY EUV_PEAK_REFLECTIVITY_UNIFORMITY EUV_ABSORBER_COMPOSITION	START_EUV_BLANK_TYPE EUV ブランクスタイプ EUV 表面平坦度 EUV 裏面平坦度 EUV マルチレイヤー組成 EUV キャッピング層組成 EUV 平均中央反射波長 EUV ピーク反射率の平均値 EUV ピーク反射率の均一性 EUV 吸収膜組成

	EUV_ABSORBER_OPTICAL_PROPERTIES	EUV 吸収膜光学特性
	EUV_BLANK_RESISTANCE	EUV ブランク表面裏面抵抗値
	EUV_EXPANSION_COEFF	EUV 熱膨張係数
	END_EUV_BLANK_TYPE	END_EUV_BLANK_TYPE
<ship_plot> =	START_SHIP_PLOT	START_SHIP_PLOT
	PLOT_TYPE PLOT_SCALE QUANTITY [PRICE]	PLOT_TYPE PLOT_SCALE 数量 [価格]
	[PLOT_FORMAT]	[PLOT_FORMAT] [パターンプロット正反]
	[PATTERN_PLOT_NORMAL_TONE]	
	[<ship_to>]	[<ship_to>]
	END_SHIP_PLOT	END_SHIP_PLOT
<phase_shift> =	START_PHASE_SHIFT [PHASE_SHIFT_QUALITY_ID]	START_PHASE_SHIFT [位相シフト品質グレード]
	PSM_WAVELENGTH	PSM_WAVELENGTH (PSM 波長)
	[TRANSMISSION_TARGET]	[指定透過率]
	[TRANSMISSION_REFERENCE_ONLY]	[透過率合否判定省略]
	[TRANSMISSION_TOLERANCE]	[透過率平均値公差 (MTT)]
	[TRANSMISSION_RANGE]	[透過率面内均一性 (レンジ)] [透過率公差]
	[TRANSMISSION_ERROR]	
	{TRANSMISSION_EQUIP_REQD TRANSMISSION_MODE_REQD } }	{透過率測定装置 [透過率測定モード] }
	{ [TRANSMISSION_MARK_SITE_ID] TRANSMISSION_MARK_LOCATION }	{ [透過率マーク測定 ID] 透過率測定マーク配置座標 }
	[TRANSMISSION_MARK_FEATURE]	[透過率マーク]
	[TRANSMISSION_MARK_LOCATION_DRAWING]	[透過率マーク配置指示書]
	[TRANSMISSION_MARK_DRAWING]]	[透過率マーク指示書]]
	[PHASE_ANGLE_TARGET]	[指定位相差]
	[PHASE_ANGLE_REFERENCE_ONLY]	[位相差合否判定省略]
	[PHASE_ANGLE_TOLERANCE]	[位相差平均値公差 (MTT)]
	[PHASE_ANGLE_RANGE] [PHASE_ANGLE_ERROR]	[位相差面内均一性 (レンジ)] [位相差公差]
	{PHASE_ANGLE_EQUIP_REQD PHASE_ANGLE_MODE_REQD } }	{位相差測定装置 [位相差測定モード] }
	{ [PHASE_ANGLE_SITE_ID] PHASE_ANGLE_MARK_LOCATION }	{ [位相差測定 ID] 位相差マーク配置座標 }
	[PHASE_ANGLE_MARK_FEATURE]	[位相差マーク]
	[PHASE_ANGLE_MARK_LOCATION_DRAWING]	[位相差マーク配置指示書]
	[PHASE_ANGLE_MARK_DRAWING]]	[位相差マーク指示書]]
	[ETCH_DEPTH_TARGET]	[指定エッチング深さ]
	[ETCH_DEPTH_REFERENCE_ONLY]	[エッチング深さ合否判定省略]
	[ETCH_DEPTH_TOLERANCE]	[エッチング深さ平均値公差 (MTT)]
	[ETCH_DEPTH_RANGE] [ETCH_DEPTH_ERROR]	[エッチング深さ面内均一性 (レンジ)] [エッチング深さ公差]
	{ETCH_DEPTH_EQUIP_REQD ETCH_DEPTH_MODE_REQD } }	{エッチング深さ測定装置 [エッチング深さ測定モード] }

{ [ETCH_DEPTH_SITE_ID] ETCH_DEPTH_MARK_LOCATION }	{ [エッチング深さ測定 ID] エッチング深さ測定マ ーク配置座標}
[ETCH_DEPTH_MARK_FEATURE]	[エッチング深さ測定マーク]
[ETCH_DEPTH_MARK_LOCATION_DRAWING]	[エッチング深さ測定マーク配置指示書]
[ETCH_DEPTH_MARK_DRAWING]]	[エッチング深さ測定マーク指示書]]
END_PHASE_SHIFT	END_PHASE_SHIFT
<registration> =	START_REGISTR [位置精度品質グレード]
[REGISTR_ERROR [REGISTR_ERROR_REFERENCE_ONLY]]	[位置精度公差 [位置精度公差(参考用)]]
[REGISTR_SCALE [REGISTR_SCALE_REFERENCE_ONLY]]	[スケール補正許容値 [REGISTR_SCALE_REFERENCE_ONLY]]
[REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE [REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE_REFERENCE_ON LY]]	[スケール異方性補正許容値 [REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE_REFE RENCE_ONLY]]
[REGISTR_RESIDUAL [REGISTR_RESIDUAL_REFERENCE_ONLY]]	[残余ばらつき最大許容値 [REGISTR_RESIDUAL_REFERENCE_ON LY]]
[REGISTR_THREE_SIGMA [REGISTR_THREE_SIGMA_REFERENCE_ONLY]]	[位置精度 (3 σ) [REGISTR_THREE_SIGMA_REFERENCE_ ONLY]]
[REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA	[残余ばらつき (3 σ)
[REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA_REFERENCE _ONLY]]	[REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA_R EFERENCE_ONLY]]
[REGISTR_TOLERANCE] [REGISTR_TOLERANCE_REFERENCE_ONLY]]	[REGISTR_TOLERANCE] [REGISTR_TOLERANCE_REFERENCE_O NLY]]
[REGISTR_ORTHO [REGISTR_ORTHO_REFERENCE_ONLY]]	[直交度エラー補正許容値 [REGISTR_ORTHO_REFERENCE_ONLY]]
[REGISTR_RELATIVE [REGISTR_RELATIVE_REFERENCE_ONLY]]	[比較測定 [REGISTR_RELATIVE_REFERENCE_ONL Y]]
{REGISTR_REF_MASK_ID REGISTR_REF_MASK_SET_ID}	{位置測定リファレンスマスク ID 位置測定リファ レンスマスクセット ID }
{REGISTR_REF_MASK_NAME REGISTR_REF_MASK_SET_NAME [REGISTR_REF_MASK_SET_VERSION] }	{位置測定リファレンスマスク名 位置測定リファレ ンスマスクセット名 [位置測定リファレンスマスクセットバージョン] }
{REGISTR_EQUIP_REQD} {EQUIP_SITE_REQD}	{位置測定装置} {装置指定}
[REGISTR_STD_GRID] {REGISTR_REF_METHOD_REQD}	[位置精度基準グリッド] {位置精度測定手法}
[REGISTR_ALGORITHM_TYPE [REGISTR_ALGORITHM_COORDINATES]] [REGISTR_COMPENSATION_TEMPERATURE]	[位置測定アルゴリズム] タイプ [REGISTR_ALGORITHM_COORDINATES] [REGISTR_COMPENSATION_TEMPERAT URE]
{ [REGISTR_MARK_ID] [MASK_REGISTR_MARK] [CELL_REGISTR_MARK]	{ [位置測定マーク ID] [位置測定マーク配置座標 (マスク上)] [位置測定マーク配置座標(セル上)]
[MEASURE_FILE_NAME]	[位置測定ファイル名]
[REGISTR_MARK_FEATURE]	[位置測定マーク]
[REGISTR_MARK_LOCATION_DRAWING] [REGISTR_MARK_DRAWING]	[位置測定マーク配置指示書] [位置測定マーク 指示書]

	[REGISTR_MARK_SEPARATION REGISTR_MARK_COUNT] }	[位置測定マーク配置ピッチ 位置測定マーク配置行列個数] }
	END_REGISTR	END_REGISTR
<cd_group> =	START_CD	START_CD
	[<cd_definition>]	[<cd_definition>]
	[NUMBER_OF_CDS]	[測定点数]
	{ [CD_SITE_ID] CD_LOCATION } [CD_MATRIX_FILE_NAME]	{ [CD サイト ID] CD 測定座標 } [CD 測定ファイル名]
	END_CD	END_CD
<cd_definition> =	[CD_QUALITY_ID] [CD_DATA] [CD_DIGITIZED] [CD_TONE_CLEAR]	[CD 測定品質グレード] [CD 設計値] [CD デジタイズ部] [CD測定白黒]
	[CD_MORPHOGRAPHY]	[CD 測定パターン]
	[CD_PERCENT_CLEAR] [CD_PERCENT_CLEAR_WINDOW]	[指定エリア開口率] [指定エリア]
	[CD_TARGET] [CD_ORIENTATION] [CD_PITCH]	[CD 指定寸法値] [CD 測定方向] [CD 測定パターンピッチ]
	[CD_FEATURE] [CD_LOCATION_DRAWING] [CD_DRAWING]	[CD 測定パターン形状] [CD 測定パターン配置指示書] [CD 測定パターン指示書]
	[CD_REFERENCE_ONLY]	[CD 合否判定省略]
	[CD_TOLERANCE]	[CD 平均値公差 (MTT)]
	[CD_RANGE] [CD_THREE_SIGMA]	[CD 面内均一性 (レンジ)] [CD 面内均一性 (3 σ)]
	[CD_DEVIATION_FROM_TARGET] [CD_DEVIATION_FROM_MEAN]	[CD 全点公差 (CD 指定寸法値基準)] [CD 全点公差 (測定平均値基準)]
	[CD_STD] [CD_CORRELATION_ID]	[CD 測定基準] [CD コリレーション ID]
	{CD_EQUIP_REQD} {EQUIP_SITE_REQD}	{CD 測定装置} {装置指定}
<cd_set> =	START_CD_SET	START_CD_SET
	{CD_GROUP_NAME}	{ CD 測定グループ名}
	[CD_REFERENCE_ONLY]	[CD 合否判定省略]
	[CD_QUALITY_ID]	[CD 測定品質グレード ID]
	[CD_TOLERANCE] [CD_RANGE] [CD_THREE_SIGMA]	[CD 平均値公差 (MTT)] [CD 面内均一性 (レンジ)] [CD 面内均一性 (3 σ)]
	[CD_DEVIATION_FROM_TARGET] [CD_DEVIATION_FROM_MEAN]	[CD 全点公差 (CD 指定寸法値基準)] [CD 全点公差 (測定平均値基準)]
	[CD_STD] [CD_CORRELATION_ID]	[CD 測定基準] [CD コリレーション ID]
	END_CD_SET	END_CD_SET
<cd_xy_definition> =	START_CD_XY_DEFINITION	START_CD_XY_DEFINITION
	{CD_X_GROUP} {CD_Y_GROUP}	{CD_X_GROUP} {CD_Y_GROUP}
	{<cd_xy_site>}	{<cd_xy_site>}
	[CD_XY_TOLERANCE] [CD_XY_DEVIATION]	[CD_XY 寸法平均値公差 (MTT)] [CD_XY 寸法差 (全点)]
	[CD_FEATURE] [CD_LOCATION_DRAWING] [CD_DRAWING]	[CD 測定パターン形状] [CD 測定パターン配置指示書] [CD 測定パターン指示書]
	[CD_XY_REFERENCE_ONLY]	[CD_XY 寸法差合否判定省略]
	END_CD_XY_DEFINITION	END_CD_XY_DEFINITION
<cd_xy_site> =	START_CD_XY_SITE	START_CD_XY_SITE

	{ [CD_HORIZONTAL_ID] CD_HORIZONTAL_LOCATION [CD_VERTICAL_ID] CD_VERTICAL_LOCATION }	{ [CD_X 方向測定 ID] CD_X 方向測定座標 [CD_Y 方向測定 ID] CD_Y 方向測定座標 }
	END_CD_XY_SITE	END_CD_XY_SITE
<cd_clear_dark_definition> =	START_CD_CLEAR_DARK	START_CD_CLEAR_DARK
	CD_CLEAR_SET	CD_CLEAR_SET
	CD_DARK_SET	CD_DARK_SET
	[CD_CLEAR_DARK_TOLERANCE]	[CD_CLEAR_DARK_TOLERANCE]
	[CD_CLEAR_DARK_REFERENCE_ONLY]	[CD_CLEAR_DARK_REFERENCE_ONLY]
	END_CD_CLEAR_DARK	END_CD_CLEAR_DARK
<cd_same_tone_definition> =	START_CD_SAME_TONE	START_CD_SAME_TONE
	CD_SAME_TONE_SET	CD_SAME_TONE_SET
	CD_SAME_TONE_SET	CD_SAME_TONE_SET
	[CD_SAME_TONE_TOLERANCE]	[CD_SAME_TONE_TOLERANCE]
	[CD_SAME_TONE_REFERENCE_ONLY]	[CD_SAME_TONE_REFERENCE_ONLY]
	END_CD_SAME_TONE	END_CD_SAME_TONE
<opc_definition> =	START_OPC	START_OPC
	[OPC_TYPE [OPC_MINIMUM_FEATURE_SIZE] [OPC_MINIMUM_GAP]	[OPC 種別 [OPC 最小パターン寸法] [OPC 最小ギャップ]
	[OPC_PATTERN_SEPARATE] [OPC_PATTERN_MODIFIABLE]]	[OPC パターンセパレート] [OPC パターンデータ修正可否]]
	END_OPC	END_OPC
<defect_definition> =	START_DEFECT_DEFINITION [DEFECT_QUALITY_ID]	START_DEFECT_DEFINITION [欠陥品質 グレード ID]
	[VISUAL_INSPECTION_OK] [VISUAL_INSPECTION_REQD]	[目視検査適用] [目視検査要否]
	{VISUAL_INSP_CRITERIA}	{VISUAL_INSP_CRITERIA}
	[AUTO_INSPECTION_REQD] [DIE_TO_DIE_INSPECTION]	[欠陥検査機による検査要否] [DD 検査要否]
	[DEFECT_SIZE] [DEFECT_SIZE_CL] [DEFECT_SIZE_DK]	[欠陥許容サイズ(全タイプ)] [白欠陥許容サイズ] [黒欠陥許容サイズ]
	[DEFECT_SIZE_CL_ADJ] [DEFECT_SIZE_CL_ADJ_REP]	[非繰返しエッジ白欠陥許容サイズ] [繰返しエッジ 白欠陥許容サイズ]
	[DEFECT_SIZE_DK_ADJ] [DEFECT_SIZE_DK_ADJ_REP]	[非繰返しエッジ黒欠陥許容サイズ] [繰返しエッジ 黒欠陥許容サイズ]
	[DEFECT_SIZE_CL_ISO] [DEFECT_SIZE_CL_ISO_REP]	[非繰返し孤立白欠陥許容サイズ] [繰返し孤立 白欠陥許容サイズ]
	[DEFECT_SIZE_DK_ISO] [DEFECT_SIZE_DK_ISO_REP]	[非繰返し孤立黒欠陥許容サイズ] [繰返し孤立 黒欠陥許容サイズ]
	[DEFECT_DENSITY] [DEFECT_COUNT] [DEFECT_COUNT_REP]	[1cm 角内欠陥許容数] [許容欠陥個数] [許容 繰返し欠陥個数]
	[DEFECTIVE_DIE_DENSITY] [DEFECTIVE_DIE_COUNT]	[欠陥ダイ許容欠陥密度] [欠陥許容ダイ数]
	[DEFECTIVE_DIE_COUNT_REP]	[繰返し欠陥許容ダイ数]
	[PERCENT_DEFECTIVE_DIE]	[欠陥許容ダイ率]

[EDGE_ROUGHNESS]	[エッジラフネス]
{INSPECTION_AREA} [INSPECTION_BORDER] {INSPECTION_AREA_EXCLUDE}	{欠陥検査領域指定} [欠陥検査境界] {欠陥検査除外領域指定}
{SCRATCH_SIZE_FRONT {SCRATCH_INSP_AREA {SCRATCH_INSP_EXCLUDE }}}	{パターン面スクラッチ許容サイズ {スクラッチ検査領域 {スクラッチ検査除外領域 }}}
{SCRATCH_SIZE_BACK {SCRATCH_INSP_AREA {SCRATCH_INSP_EXCLUDE }}}	{ガラス面スクラッチ許容サイズ {スクラッチ検査領域 {スクラッチ検査除外領域 }}}
[GOOD_FIELDS]	[GOOD FIELDS 指定]
{DEFECT_EQUIP_REQD {EQUIP_SITE_REQD} [DEFECT_INSP_MODE_REQD]	{欠陥検査装置 {装置指定} [欠陥検査モード]
[DEFECT_INSP_PIXEL_SIZE_REQD]	[欠陥検査ピクセルサイズ]
{ DEFECT_TYPE DEFECT_INSP_SENSITIVITY_REQD { BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_REQD } }	{ DEFECT_TYPE DEFECT_INSP_SENSITIVITY_REQD { ビンサイズ SEVERITY_CRITERION_REQD } }
[DEFECT_SETUP_FILE_NAME_REQD] }	[DEFECT_SETUP_FILE_NAME_REQD] }
[<database_inspection>]	[<database_inspection>]
[<repair_definition>]	[<repair_definition>]
END_DEFECT_DEFINITION	END_DEFECT_DEFINITION
<database_inspection> DATABASE_INSPECTION [PRICE] =	DB 検査要否 [価格]
[DATABASE_SOURCE]	[検査データソース]
[DATABASE_TOP_CELL DATABASE_LAYER]	[DB トップセル名 DB レイヤ]
[DATABASE_FILE_NAME]	[DB ファイル名]
[DATABASE_UNIT] [USER_UNIT]	[DB 最小グリッド] [ユーザーユニット]
[DATABASE_WITH_JOB [DATABASE_JOB_NAME DATABASE_JOB_LEVEL]]	[DB 検査用ジョブ [DB 検査用ジョブ名 DB ジョブレベル]]
{DATABASE_AREA}	{ DB 検査領域}
<repair_definition> = START_REPAIR_DEFINITION	START_REPAIR_DEFINITION
{ REPAIR_EQUIP_REQD {EQUIP_SITE_REQD} }	{ REPAIR_EQUIP_REQD {装置指定} }
END_REPAIR_DEFINITION	END_REPAIR_DEFINITION
<surface_definition> = START_SURFACE_DEFINITION	START_SURFACE_DEFINITION
[SURFACE_INSPECTION] [SURFACE_QUALITY_ID]	[異物検査] [異物品質グレード ID]
{ [SURF_INSP_EQUIP_REQD] {EQUIP_SITE_REQD} [SURF_INSP_MODE_REQD]	{ [異物検査装置] {装置指定} [異物検査モード]
[SURF_INSP_PIXEL_SIZE_REQD]	[異物検査ピクセルサイズ]
{SURF_DEFECT_TYPE	{異物カテゴリー
SURF_INSP_SENSITIVITY_REQD	SURF_INSP_SENSITIVITY_REQD
{ BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_REQD }	{ ビンサイズ SEVERITY_CRITERION_REQD } }
[SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_REQD] }	[SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_REQD] }
[SURF_INSP_METHOD] [SURF_INSP_AREA]	[異物検査方法] [異物検査領域]
[SURF_INSP_PELL_TOP]	[パターン面ベリクル上許容異物サイズ]

[SURF_INSP_PELL_TOP_ON_CLEAR_PATTERN]	[パターン面許容異物サイズ(開口部)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_ON_OPAQUE_PATTERN]	[パターン面許容異物サイズ(遮光膜部)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_OUTSIDE_FRAME]	[パターン面許容異物サイズ(フレーム領域外)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_OUTSIDE_ON_OPAQUE]	[パターン面遮光部許容異物サイズ(フレーム領域外)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_OUTSIDE_MEMBRANE]	[パターン面メンブレン許容異物サイズ(外接部)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_INSIDE_MEMBRANE]	[パターン面メンブレン許容異物サイズ(内接部)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_OUTSIDE_ON_FRAME]	[パターン面フレーム許容異物サイズ(外接部)]
[SURF_INSP_PELL_TOP_INSIDE_ON_FRAME]	[パターン面フレーム許容異物サイズ(内接部)]
[SURF_INSP_PELL_BOTTOM]	[ガラス面側許容異物サイズ(ペリクル装着)]
[SURF_INSP_GLASS_SIDE]	[ガラス面許容異物サイズ(ペリクル非装着)]
[SURF_INSP_PATTERN_SIDE]	[パターン面許容異物サイズ(ペリクル非装着)]
[TRANSMISSION_DEFECT_CLEAR]	[白欠陥の許容透過率]
[TRANSMISSION_DEFECT_DARK]	[黒欠陥の許容遮光率]
END_SURFACE_DEFINITION	END_SURFACE_DEFINITION
<contamination> =	CONTAMINANT CONTAMINATION_LEVEL CONTAMINATION_METHOD [コンタミネーション方法]
<sem_photo> =	{START_SEM_PHOTO { [SEM_PHOTO_SITE_ID] SEM_PHOTO_LOCATION } { [SEM 写真ID] SEM 座標 } [SEM_PHOTO_MATRIX_FILENAME] [SEM ファイル名] [CD_FEATURE] [CD_LOCATION_DRAWING] [CD 測定パターン形状] [CD 測定パターン配置指示書] [CD_DRAWING] [CD 測定パターン指示書] [SEM_PHOTO_SCALE] [SEM 写真観察倍率] [SEM_PHOTO_TILT] [SEM_PHOTO_ROTATION] [SEM 写真チルト角度] [SEM 写真回転角度] END_SEM_PHOTO }
<mask_definition> =	MASK_ID [MASK_NAME [MASK_NAME_VERSION]] MASK_ID [MASK_NAME [MASK_NAME_VERSION]] [CUSTOMER_LAYER_NAME] [顧客用レイヤー名] DELIVERABLE_MASK <mask_options> END_MASK
<cell_definition> =	CELL_ID [<pattern_options>] END_CELL_OPTIONS {<cell_instance>} {<pattern_instance>} END_CELL END_CELL
<pattern_group> =	PATTERN_GROUP_ID [<pattern_options>] END_PATTERN_GROUP_OPTIONS {<pattern_definitions>} END_PATTERN_GROUP
<pattern_definitions> =	LEVEL_ID レベル ID [PATTERN_NAME] [PATTERN_VISUAL_ID] [パターンファイル名] [パターン内印字の確認要 [FIGURE_COUNT] 否] [図形数] [MINIMUM_FEATURE_SIZE] [最小寸法サイズ {最小寸法パターン配置座標}] {<opc_definition>}

	[OPTICAL_MASK_SET_ID OPTICAL_MASK_ID]	[原版マスクセット ID 原版マスク ID]
	[OPTICAL_MASK_TITLE]	[原版マスクタイトル]
	<pattern_options>	<pattern_options>
	END_PATTERN_DEFINITION	END_PATTERN_DEFINITION
<cell_instance> =	CELL_INSTANCE [<pattern_options>]	セルインスタンス [<pattern_options>]
	END_CELL_INSTANCE_OPTIONS {<placement>}	END_CELL_INSTANCE_OPTIONS {<placement>}
	END_CELL_INSTANCE	END_CELL_INSTANCE
<pattern_instance> =	PATTERN_GROUP_INSTANCE [<pattern_options>]	パターングループインスタンス [<pattern_options>]
	{<placement>}	{<placement>}
	END_PATTERN_GROUP_INSTANCE	END_PATTERN_GROUP_INSTANCE
<placement> =	START_PLACEMENT	START_PLACEMENT
	{ LOCATION [STEPPING_DISTANCE STEPPING_COUNT]	{ 配置座標 [配列ピッチ 配列個数]
	{ DROPOUT [SCRIBE_TONE SCRIBE_INSIDE_CORNERS SCRIBE_OUTSIDE_CORNERS] }	{ ドロップアウトパターン(セル) [スクライプトーン スクライブ内枠サイズ スクライブ外枠サイズ] }
	[ARRAY_DIAMETER ARRAY_CENTER [ARRAY_DIAMETER_INCLUSIVE]]	[円形配列直径 円形配列中心座標 [円形配列境界部処理]]
	[LOCATION_SPEC]	[配置規格]
	END_PLACEMENT	END_PLACEMENT
<pattern_options> =	START_PATTERN_OPTIONS [PATTERN_FUNCTION]	START_PATTERN_OPTIONS[パターン種類]
	{PATTERN_EXPORT_NUMBER} {CHIP_EXPORT_NUMBER}	{パターンエクスポート番号} {チップエクスポート番号}
	[DATA_FILE_SIZE] [DATA_CHECKSUM DATA_CHECKSUM_TYPE]	[データファイルサイズ] [データチェックサム データチェックサムタイプ]
	[PATTERN_ADDRESS_SIZE] [SCALE_FACTOR]	[データアドレスユニット] [描画時縮小率]
	[DIGITIZED_DATA_DARK]	[マスクトーン]
	[STRIPE_HEIGHT]	[ストライプハイト]
	[UNSCALED_PATTERN_SIZE]	[パターンサイズ(スケーリング前)]
	[MFG_BIAS_PREAPPLIED]	[マスクプロセスバイアス]
	{ LITHO_MODE_REQD } [VIRTUAL_ADDRESS]	{描画モード} [VIRTUAL_ADDRESS]
	[SURROUNDING_TONE SURROUNDING_WIDTH SURROUNDING_HEIGHT]	[パターン外周白黒 パターン外周白黒横幅 パターン外周白黒縦幅]
	[DATA_PATTERN_WINDOW]	[パターン領域]
	[MIRROR_PATTERN]	[パターンミラー処理]
	<ship_plot> [PATTERN_PLOT_APPR_REQD]	<ship_plot> [作製前パターンプロット承認]
	<phase_shift>	<phase_shift>
	<registration>	<registration>
	<cd_group>	<cd_group>
	<cd_set>	<cd_set>
	<cd_xy_definition>	<cd_xy_definition>
	<cd_clear_dark_definition>	<cd_clear_dark_definition>

{<cd_same_tone_definition>}	{<cd_same_tone_definition>}
[MULTI_LAYER_FIELD [PERCENT_CLEAR_REQUESTED [PERCENT_CLEAR_WINDOW]]]	[マルチレイヤーフィールド [マスクパターン開口率要否 [マスクパターンウィンドウ開口率]]]
[PERCENT_CLEAR [PERCENT_CLEAR_WINDOW]]	[マスク開口率] [マスクウィンドウ開口率]]
[INSPECT_ALL_SITES]	[全パターン検査要否]
{<defect_definition>}	{<defect_definition>}
{<sem_photo>}	{<sem_photo>}
[BUTTING_ERROR [BUTTING_ERROR_METHOD]]	[BUTTING_ERROR [BUTTING_ERROR_METHOD]]
[ADDITIONAL_PATTERN_INFO]	[パターン追加情報]
END_PATTERN_OPTIONS	END_PATTERN_OPTIONS
START_SHIPPABLE_DATA	START_SHIPPABLE_DATA
[SEND_MASK_SHIPPED_DATE_TIME [<ship_to>]]	[SEND_MASK_SHIPPED_DATE_TIME [<ship_to>]]
[SEND_FINAL_AUDIT_DATE_TIME [<ship_to>]]	[SEND_FINAL_AUDIT_DATE_TIME [<ship_to>]]
[SHIP_CD_DATA [<ship_to>]]	[CD測定データ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_CD_PRINTOUT [<ship_to>]]	[CD測定結果印刷要否 [<ship_to>]]
[SHIP_CD_UNIFORMITY_MAP [<ship_to>]]	[CD面内マップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_AIM_DATA [<ship_to>]]	[SHIP_AIM_DATA 要否 [<ship_to>]]
[SHIP_DEFECT_DATA [<ship_to>]]	[欠陥検査結果要否 [<ship_to>]]
[SHIP_THRU_PELLCLE_DATA [<ship_to>]]	[ベリクル装着後欠陥検査結果要否 [<ship_to>]]
[SHIP_MANUAL_INSPECTION_FORM [<ship_to>]]	[目視検査結果要否 [<ship_to>]]
[SHIP_INSP_DATABASE_DATA [INSP_DATABASE_DATA_FORMAT] [<ship_to>]]	[DB欠陥検査用データ要否 [欠陥検査データフォーマット] [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_PREPELL_DIE_DB_MSK_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前初回DB欠陥検査マップ要否 (パターン毎) [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_PREPELL_DIE_DB_PTN_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前初回DB欠陥検査マップ要否 (パターン毎) [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_PREPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前初回DD欠陥検査マップ要否 (検査領域全体) [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_ROT_PREPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前初回DD欠陥検査マップ要否 (検査領域全体, 回転有) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_PREPELL_DIE_DB_MSK_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前最終DB欠陥検査マップ要否 (検査領域全体) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_PREPELL_DIE_DB_PTN_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前最終DB欠陥検査マップ要否 (パターン毎) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_PREPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前最終DD欠陥検査マップ要否 (検査領域全体) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_ROT_PREPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着前最終DD欠陥検査マップ要否 (検査領域全体, 回転有) [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_POSTPELL_DIE_DB_MSK_MAP [<ship_to>]]	[ベリクル装着後初回DB欠陥検査マップ要否 (検査領域全体) [<ship_to>]]

[SHIP_FIRST_POSTPELL_DIE_DB_PTN_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後初回DB欠陥検査マップ要否(パターン毎) [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_POSTPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後初回DD欠陥検査マップ要否(検査領域全体) [<ship_to>]]
[SHIP_FIRST_ROT_POSTPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後初回DD欠陥検査マップ要否(検査領域全体, 回転有) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_POSTPELL_DIE_DB_MSK_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終DB欠陥検査マップ要否(検査領域全体) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_POSTPELL_DIE_DB_PTN_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終DB欠陥検査マップ要否(パターン毎) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_POSTPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終DD欠陥検査マップ要否(検査領域全体) [<ship_to>]]
[SHIP_FINAL_ROT_POSTPELL_DIE_DIE_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終DD欠陥検査マップ要否(検査領域全体, 回転有) [<ship_to>]]
[SHIP_REPAIR_DATA [<ship_to>]]	[欠陥修正データ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_REGISTR_DATA [<ship_to>]]	[位置測定データ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_ARRAY_REGISTR_MAP [<ship_to>]]	[アレイ位置精度マップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_CLOSURE_DATA [<ship_to>]]	[クロージャデータ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_DIE_FIT_MAP [<ship_to>]]	[DIE-FITマップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_MEASURE_FILE_REGISTR_MAP [<ship_to>]]	[位置精度マップ測定ファイル要否 [<ship_to>]]
[SHIP_FIELD_FIT_MAP [<ship_to>]]	[FIELD-FITマップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_CENTRALITY_DATA [<ship_to>]]	[セントラリティ測定結果要否 [<ship_to>]]
[SHIP_CENTRALITY_MAP [<ship_to>]]	[セントラリティマップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_SURF_INSP_MEASUREMENTS [<ship_to>]]	[異物検査結果要否 [<ship_to>]]
[SHIP_SURF_INSPECTION_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終異物検査マップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_SURF_INSP_PELL_TOP_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終異物検査マップ要否(パターン面ペリクル上) [<ship_to>]]
[SHIP_SURF_INSP_PELL_BOTTOM_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終異物検査マップ要否(ガラス面ペリクル上) [<ship_to>]]
[SHIP_SURF_INSP_GLASS_SIDE_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終異物検査マップ要否(ガラス面) [<ship_to>]]
[SHIP_SURF_INSP_PATTERN_SIDE_MAP [<ship_to>]]	[ペリクル装着後最終異物検査マップ要否(パターン面) [<ship_to>]]
[SHIP_STARLIGHT_MAP [<ship_to>]]	[スターライト検査マップ要否 [<ship_to>]]
[SHIP_PHASE_SHIFT_MEASUREMENTS [<ship_to>]]	[位相シフトマスク測定結果要否 [<ship_to>]]
[SHIP_PHASE_SHIFT_REPORT [<ship_to>]]	[位相シフトマスク報告書要否 [<ship_to>]]
[SHIP_SEM_PHOTOS [<ship_to>]]	[SEM写真要否 [<ship_to>]]
{<ship_plot>}	{<ship_plot>}
[SHIP_CERTIFICATE_OF_CONFORMANCE [<ship_to>]]	[検査成績書要否 [<ship_to>]]
{SHIP_CUSTOMER_QUALITY_FORM [<ship_to>]}	{客先指定検査成績書要否 [<ship_to>]}
[SHIP_TRAVELER [<ship_to>]]	[製造履歴報告要否 [<ship_to>]]
[PERCENT_CLEAR_REQUESTED [PERCENT_CLEAR_WINDOW] [<ship_to>]]	[マスクパターン開口率要否 [マスクウィンドウ開口率] [<ship_to>]]

	{SHIP_SPECIAL_REQUEST [<ship_to>]}	{その他客先要求事項 [<ship_to>]}
	END_SHIPPABLE_DATA	END_SHIPPABLE_DATA
<ship_to> =	START_SHIP_TO	START_SHIP_TO
	{EMAIL_ADDRESS} [<ftp_address>] {ウェブ_ADDRESS}	{送付先E-MAILアドレス} [<ftp_address>] [URLアドレス]
	{MAILING_ADDRESS} [SHIP_TO_FAX]	{郵送先} [送付先 FAX 番号]
	[DUE_DATE_TIME_REQUESTED]	[要求納期日時]
	END_SHIP_TO	END_SHIP_TO
<ftp_address> =	FTP_HOST_NAME [FTP_LOGIN] [FTP_PASSWORD] [FTP_DIRECTORY]	FTP ホスト名 [FTP ログイン名] [FTP パスワー ド] [FTP ディレクトリ]
	[FTP_MODE] END_FTP_HOST	[FTP モード] END_FTP_HOST
end bnf	maskOrder	

7.5 マスク結果データ構造シンタックス※ (Mask Results Data Structure Syntax) — 以下のシンタックス定義は、マスク結果データ構造内で一致するデータ記録の許容されたアプリケーションを表すため、上述のキーワードを使用するものである。この構造により、製作中のマスクに関する実データをベンダーが顧客に提供することが可能となる。

		(日本語統一項目名称)
start bnf	maskResults	maskResults
<mask_results> =	START_MASK_RESULTS SEMI_REVISION CUSTOMER VENDOR	START_MASK_RESULTS SEMI REVISION 発注元 作製先
	FILE_DATE_TIME [OPERATOR_NAME]	仕様書発行日時 [入力者名]
	MASK_SET_ID [MASK_SET_NAME [MASK_SET_VERSION]]	マスクセット ID [マスクセット名 [マスクセットバー ジョン]]
	[CUSTOMER_MASK_SET_NAME]	[顧客用マスクセット ID] [注文 ID]
	[BLANKET_PO_NUMBER] [PO_NUMBER] [SO_NUMBER]	[BLANKET_PO_NUMBER] [PO_NUMBER] [SO_NUMBER]
	[ORDER_ID]	[ORDER_ID]
	[RELEASE_NUMBER] [LINE_ITEM_NUMBER] [QUOTE_NUMBER]	[RELEASE_NUMBER] [LINE_ITEM_NUMBER] [QUOTE_NUMBER]
	[<vendor_info>]	[<vendor_info>]
	{MASK_GROUP_ID [<vendor_info>]	{マスクグループ ID [<vendor_info>]
	{MASK_ID [MASK_NAME [MASK_NAME_VERSION]]	{ MASK_ID [MASK_NAME [MASK_NAME_VERSION]]
	[CUSTOMER_LAYER_NAME]	[CUSTOMER_LAYER_NAME]
	<mask_results_options>	<mask_results_options>
	END_MASK}	END_MASK}
	END_MASK_GROUP}	END_MASK_GROUP}
	END_MASK_SET	END_MASK_SET
	END_MASK_RESULTS	END_MASK_RESULTS
	[CHECKSUM]	チェックサム
<mask_results_options> =	START_MASK_RESULTS_OPTIONS	START_MASK_RESULTS_OPTIONS

※シンタックスの「日本語統一名称」欄(最右列)は、独立行政法人産業技術総合研究所と株式会社先端 SoC 基板技術開発が実施した「最先端システムオンチップ設計製造技術に関する研究」の成果を使用している。

[STATUS]	[製作指示]
[<vendor_info>]	[<vendor_info>]
[<billing_information>]	[<billing_information>]
[<materials_used >]	[<materials_used >]
{MFG_SITE_REQD} [MFG_SITE_USED]	{作製工場指定} [MFG_SITE_USED]
PRODUCT_TYPE [SERVICE_TYPE]	マスク区分[サービスタイプ] [マスク倍率] [マスク種別]
[PRODUCT_MAGNIFICATION]	
[PRODUCT_IMAGING_TYPE]	
{ TITLE_TEXT [TITLE_TYPE] }	{ タイトルテキスト [タイトル分類] }
[DUE_DATE_TIME_COMMITTED]	[DUE_DATE_TIME_COMMITTED]
[ELAPSED_TIME_COMMITTED]	[ELAPSED_TIME_COMMITTED]
[MILESTONE [ADDITIONAL_MILESTONE_INFO]]	[MILESTONE [ADDITIONAL_MILESTONE_INFO]]
[PERIODIC_UPDATE [ADDITIONAL_MILESTONE_INFO]]	[PERIODIC_UPDATE [ADDITIONAL_MILESTONE_INFO]]
[ESTIMATED_ARRIVAL [ADDITIONAL_MILESTONE_INFO]]	[ESTIMATED_ARRIVAL [ADDITIONAL_MILESTONE_INFO]]
[MASK_SHIPPED_DATE_TIME]	[MASK_SHIPPED_DATE_TIME]
[FINAL_AUDIT_DATE_TIME]	[FINAL_AUDIT_DATE_TIME]
[DESIGN_RULE]	[設計ルール]
{MASK_EXPORT_NUMBER} [SECURITY_CLASS]	{マスクエクスポート番号} [機密区分]
[<wafer_exposure_data> <aerial_image_data>]	[<wafer_exposure_data> <aerial_image_data>]
[FAB_TECHNOLOGY] [WAFER_FAB]	[ファブ・テクノロジー] [ウェハ工場]
[JOB_ONLY_APPROVED]	[JOB_ONLY_APPROVED]
[JOB_WITH_PATTERNS_APPROVED]	[JOB_WITH_PATTERNS_APPROVED]
[ALL_PATTERNS_APPROVED]	[ALL_PATTERNS_APPROVED]
[APPROVAL_GRANTED]	[APPROVAL_GRANTED]
[MIRROR_MASK] [MASK_ROTATION]	[マスクミラー処理] [マスク回転]
{CUSTOMER_SPEC CUSTOMER_SPEC_REVISION}	{顧客共通仕様書 顧客共通仕様書}
{WAIVER} {WAIVER_OVERRIDE}	{規格免除} {規格免除不可}
{ [BARCODE_TYPE] BARCODE_TEXT [BARCODE_TEXT_REFERENCE_ONLY]	{ [バーコード形式] バーコードテキスト [バーコードテキスト(参考用)]
BARCODE_ROTATION }	バーコード回転角度 }
[SHIPPING_METHOD_USED]	[SHIPPING_METHOD_USED]
{ [MULTI_LAYER_FIELD] MEASURED_PERCENT_CLEAR	{ [マルチレイヤーフィールド] マスク開口率測定
[PERCENT_CLEAR_WINDOW] }	[マスク開口領域率] }
[CENTRALITY] [MEASURED_CENTRALITY]	[パターンセントラリティ] [MEASURED_CENTRALITY]
{<litho_information>}	{<litho_information>}
{<pattern_group_results>}	{<pattern_group_results>}
{<phase_shift_measurements>}	{<phase_shift_measurements>}
{<registr_measurements>}	{<registr_measurements>}
{<closure_measurements>}	{<closure_measurements>}

	{<cd_group_measurements>}	{<cd_group_measurements>}
	{<cd_set_results>}	{<cd_set_results>}
	{<cd_xy_results>}	{<cd_xy_results>}
	{<cd_clear_dark_results>}	{<cd_clear_dark_results>}
	{<cd_same_tone_results>}	{<cd_same_tone_results>}
	{<defect_measurements>}	{<defect_measurements>}
	[THROUGH_PELLCLE_DEFECTS {<defect_measurements>}]	[THROUGH_PELLCLE_DEFECTS {<defect_measurements>}]
	{<surface_insp_measurements>}	{<surface_insp_measurements>}
	{<contamination_measurements>}	{<コンタミネーション測定>}
	[QUALITY_GROUP_ID]	[品質グレード ID]
	[FINAL_QC_AUDITOR]	[FINAL_QC_AUDITOR]
	{ADDITIONAL_RESULTS_INFO}	{ADDITIONAL_RESULTS_INFO}
	END_MASK_RESULTS_OPTIONS	END_MASK_RESULTS_OPTIONS
<vendor_info> =	START_VENDOR_INFO	START_VENDOR_INFO
	[VENDOR_CONTACT] [VENDOR_PHONE] {VENDOR_ADDRESS}	[ベンダー担当名] [ベンダー電話番号] {ベンダー住所}
	[VENDOR_FAX] [VENDOR_EMAIL]	[ベンダーFAX 番号] [ベンダーEMAIL アドレス]
	[FINAL_QC_AUDITOR]	[FINAL_QC_AUDITOR]
	[VENDOR_ORDER_ID]	[VENDOR_ORDER_ID]
	END_VENDOR_INFO	END_VENDOR_INFO
<billing_information> =	START_BILLING_INFORMATION	START_BILLING_INFORMATION
	[BLANKET_PO_NUMBER] [PO_NUMBER] [SO_NUMBER] [RELEASE_NUMBER]	[包括注文番号] [注文番号] [受注番号] [包括注文番号リリース番号]
	END_BILLING_INFORMATION	END_BILLING_INFORMATION
<materials_used> =	START_MATERIALS_USED	START_MATERIALS_USED
	[TOP_PELLCLE_USED] [BOTTOM_PELLCLE_USED]	[TOP_PELLCLE_USED] [BOTTOM_PELLCLE_USED]
	[PACKAGE_USED]	[PACKAGE_USED]
	[<substrate>] END_MATERIALS_USED	[<substrate>] END_MATERIALS_USED
<substrate> =	START_SUBSTRATE	START_SUBSTRATE
	BLANK_LENGTH [BLANK_WIDTH] BLANK_THICKNESS [BLANK_SIZE]	ブランクス長さ [ブランクス幅] ブランクス厚さ [ブランクスサイズ]
	BLANK_TYPE [BLANK_GRADE]	ブランクス基板材質 [ブランクスグレード]
	[BLANK_FLATNESS] [BLANK_FLATNESS_USED] [BLANK_VENDOR]	[ブランクス平坦度] [BLANK_FLATNESS_USED] [ブランクスベンダー]
	[BLANK_BIREFRINGENCE_REQD] [BLANK_BIREFRINGENCE_USED]	[BLANK_BIREFRINGENCE_REQD] [BLANK_BIREFRINGENCE_USED]
	{<coating>}	{<coating>}
	[BLANK_INDEX_OF_REFRACTION]	[BLANK_INDEX_OF_REFRACTION]
	[MINIMUM_BINARY_TRANSMITTANCE]	[BINARY 透過率最小値]
	[MEASURED_BINARY_TRANSMITTANCE]	[BINARY 透過率測定]

<coating> =	[BLANK_LOT_REQD] [BLANK_LOT]	[ブランクスロット(必須項目)] [ブランクスロット]
	[BLANK_DATE_OF_MFG]	[ブランク製造日]
	[MASK_BLANK_ID]	[マスクブランク ID]
	[ADDITIONAL_SUBSTRATE_INFO]	[基板追加情報]
	[<euv_blank_type>] END_SUBSTRATE	[<euv_blank_type>] END_SUBSTRATE
	START_COATING	START_COATING
	COATING_TYPE [COATING_COMPOSITION]	遮光膜タイプ [遮光膜構成] [遮光膜厚]
	[COATING_THICKNESS]	
	[COATING_REFLECTANCE]	[遮光膜反射率] [遮光膜透過率]
	[COATING_TRANSMITTANCE]	
<euv_blank_type> =	[COATING_WAVELENGTH] [COATING_GRADE]	[遮光膜波長] [遮光膜グレード]
	[COATING_PHASE]	[遮光膜位相]
	[MINIMUM_COATING_OPTICAL_DENSITY]	[遮光膜光学密度最低値] [遮光膜光学密度]
	[COATING_OPTICAL_DENSITY]	
	[COATING_LOT_NUMBER] [COATING_DATE_TIME]	[遮光膜ロット番号] [遮光膜処理日時]
	[COATING_MASK_VENDOR_APPLIED]	[遮光膜マスクベンダー] [遮光膜処理装置]
	[COATING_EQUIP_USED]	
	END_COATING	END_COATING
	START_EUV_BLANK_TYPE	START_EUV_BLANK_TYPE
	EUV_BLANK_TYPE	EUV ブランクスタイプ
<wafer_exposure_data> =	EUV_FLATNESS_FRONT	EUV 表面平坦度
	EUV_FLATNESS_BACK	EUV 裏面平坦度
	EUV_MULTILAYER_COMPOSITION	EUV マルチレイヤー組成
	EUV_CAPPING_COMPOSITION	EUV キャッピング層組成
	EUV_MMR_WAVELENGTH	EUV 平均中央反射波長
	EUV_MEAN_PEAK_REFLECTIVITY	EUV ピーク反射率の平均値
	EUV_PEAK_REFLECTIVITY_UNIFORMITY	EUV ピーク反射率の均一性
	EUV_ABSORBER_COMPOSITION	EUV 吸収膜組成
	EUV_ABSORBER_OPTICAL_PROPERTIES	EUV 吸収膜光学特性
	EUV_BLANK_RESISTANCE	EUV ブランク表面裏面抵抗値
<aerial_image_data> =	EUV_EXPANSION_COEFF	EUV 熱膨張係数
	END_EUV_BLANK_TYPE	EUV ブランクスタイプ
	START_WAFER_EXPOSURE_DATA	START_WAFER_EXPOSURE_DATA
	WAFAER_EXPOSURE_WAVELENGTH	WAFAER_EXPOSURE_WAVELENGTH
	WAFAER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE	WAFAER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE
	[WAFAER_EXPOSURE_SIGMA]	[WAFAER_EXPOSURE_SIGMA]
	[WAFAER_EXPOSURE_SIGMA_INNER]	[WAFAER_EXPOSURE_SIGMA_INNER]
	WAFAER_EXPOSURE_SIGMA_OUTER]	WAFAER_EXPOSURE_SIGMA_OUTER]
	WAFAER_EXPOSURE_ILLUMINATION	WAFAER_EXPOSURE_ILLUMINATION
	END_WAFER_EXPOSURE_DATA	END_WAFER_EXPOSURE_DATA
<aerial_image_data> =	START_AERIAL_IMAGE_DATA	START_AERIAL_IMAGE_DATA
	AIM_WAVELENGTH	AIM_WAVELENGTH

	[AIM_INTENSITY_VARIATION_DELTA]	[AIM_INTENSITY_VARIATION_DELTA]
	[AIM_FLUX_INTENSITY_DELTA]	[AIM_FLUX_INTENSITY_DELTA]
	[AIM_CD_DELTA]	[AIM_CD_DELTA]
	END_AERIAL_IMAGE_DATA	END_AERIAL_IMAGE_DATA
<litho_information> =	START_LITHO_INFORMATION	START_LITHO_INFORMATION
	{ [LITHO_EQUIP_REQD] {EQUIP_SITE_REQD}	{ [マスク描画方式指定] {装置指定}
	{ [LITHO_MODEL_REQD] {LITHO_MODE_REQD}	{ [描画装置] {描画モード} }}
	}}	
	[LITHO_EQUIP_USED] [EQUIP_SITE_USED]	[LITHO_EQUIP_USED]
		[EQUIP_SITE_USED]
	[LITHO_MODEL_USED] [LITHO_MODE_USED]	[LITHO_MODEL_USED]
		[LITHO_MODE_USED]
	[MACHINE_SERIAL_NUMBER]	[MACHINE_SERIAL_NUMBER]
	[MASK_SERIAL_NUMBER]	[MASK_SERIAL_NUMBER]
	[PROCESS]	[特殊プロセス名]
	[WRITE_DATE_TIME] [ELAPSED_WRITE_TIME]	[WRITE_DATE_TIME]
		[ELAPSED_WRITE_TIME]
	[OPERATOR]	[OPERATOR]
	END_LITHO_INFORMATION	END_LITHO_INFORMATION
<pattern_group_results> =	START_PATTERN_GROUP_RESULTS	START_PATTERN_GROUP_RESULTS
	PATTERN_GROUP_ID	パターングループ ID
	{PATTERN_APPROVED}	{PATTERN_APPROVED}
	{PATTERN_EXPORT_NUMBER}	{パターンエクスポート番号} {チップエクスポート番号}
	{CHIP_EXPORT_NUMBER}	
	{<phase_shift_measurements>}	{<phase_shift_measurements>}
	{<registr_measurements>}	{<registr_measurements>}
	{<closure_measurements>}	{<closure_measurements>}
	{<cd_group_measurements>}	{<cd_group_measurements>}
	{<cd_set_results>}	{<cd_set_results>}
	{<cd_xy_results>}	{<cd_xy_results>}
	{<cd_clear_dark_results>}	{<cd_clear_dark_results>}
	{<cd_same_tone_results>}	{<cd_same_tone_results>}
	{<defect_measurements>}	{<defect_measurements>}
	END_PATTERN_GROUP_RESULTS	END_PATTERN_GROUP_RESULTS
<phase_shift_measurements> =	START_PHASE_SHIFT_MEASUREMENTS	START_PHASE_SHIFT_MEASUREMENTS
	PSM_WAVELENGTH	PSM_WAVELENGTH
	[PHASE_SHIFT_QUALITY_ID]	[位相シフト品質グレード]
	[START_TRANSMISSION_MEASUREMENTS	[
		START_TRANSMISSION_MEASUREMENTS
	[TRANSMISSION_MEASUREMENT_DATE]	[透過率測定日時]
	[TRANSMISSION_EQUIP_USED]	[透過率測定器]
	[TRANSMISSION_MODE_USED]	[透過率測定モード]

[TRANSMISSION_MEASUREMENT_FILE_NAME]	[透過率測定ファイル名]
TRANSMISSION_TARGET	指定透過率
[TRANSMISSION_REFERENCE_ONLY]	[透過率合否判定省略]
[TRANSMISSION_TOLERANCE]	[透過率平均値公差 (MTT)]
[TRANSMISSION_RANGE]	[透過率面内均一性 (レンジ)]
[TRANSMISSION_ERROR]	[透過率公差]
[MEASURED_TRANSMISSION_AVERAGE]	[透過率測定結果 平均値]
[MEASURED_TRANSMISSION_TOLERANCE]	[透過率測定結果 平均公差]
[MEASURED_TRANSMISSION_RANGE]	[透過率測定結果 面内均一性 (レンジ)]
[TRANSMISSION_MARK_FEATURE]	[透過率マーク]
[TRANSMISSION_MARK_LOCATION_DRAWING]	[透過率マーク配置指示書]
[TRANSMISSION_MARK_DRAWING]	[透過率マーク指示書]
{MEASURED_TRANSMISSION_MARK_SITE_ID	{透過率マーク測定結果サイト ID
[TRANSMISSION_MARK_LOCATION]	[透過率測定マーク配置座標]
MEASURED_TRANSMISSION_MARK_LOCATION	透過率測定結果マーク座標
MEASURED_TRANSMISSION	MEASURED_TRANSMISSION
[MEASURED_TRANSMISSION_ERROR]	[透過率測定結果エラー]
END_MEASURED_TRANSMISSION_SITE }	END_MEASURED_TRANSMISSION_SITE }
END_TRANSMISSION_MEASUREMENTS]	END_TRANSMISSION_MEASUREMENTS]
[START_PHASE_ANGLE_MEASUREMENTS	[START_PHASE_ANGLE_MEASUREMENTS
[PHASE_ANGLE_MEASUREMENT_DATE]	[位相差測定日時]
[PHASE_ANGLE_EQUIP_USED]	[位相差測定装置]
[PHASE_ANGLE_MODE_USED]	[位相差測定モード]
[PHASE_ANGLE_MEASUREMENT_FILE_NAME]	[位相差測定ファイル名]
PHASE_ANGLE_TARGET	指定位相差
[PHASE_ANGLE_REFERENCE_ONLY]	[位相差合否判定省略]
[PHASE_ANGLE_TOLERANCE]	[位相差平均値公差 (MTT)]
[PHASE_ANGLE_RANGE]	[位相差面内均一性 (レンジ)]
[PHASE_ANGLE_ERROR]	[位相差公差]
[MEASURED_PHASE_ANGLE_AVERAGE]	[位相差測定結果平均値]
[MEASURED_PHASE_ANGLE_TOLERANCE]	[位相差測定結果平均値公差]
[MEASURED_PHASE_ANGLE_RANGE]	[位相差面内均一性レンジ]
[PHASE_ANGLE_MARK_FEATURE]	[位相差マーク]
[PHASE_ANGLE_MARK_LOCATION_DRAWING]	[位相差マーク配置指示書]
[PHASE_ANGLE_MARK_DRAWING]	[位相差マーク指示書]
{MEASURED_PHASE_ANGLE_MARK_SITE_ID	{位相差測定結果マークサイト ID
[PHASE_ANGLE_MARK_LOCATION]	[位相差マーク配置座標]
MEASURED_PHASE_ANGLE_MARK_LOCATION	位相差測定結果マーク配置座標

MEASURED_PHASE_ANGLE	MEASURED_PHASE_ANGLE
[MEASURED_PHASE_ANGLE_ERROR]	[位相差測定結果エラー]
END_MEASURED_PHASE_ANGLE_SITE }	END_MEASURED_PHASE_ANGLE_SITE }
END_PHASE_ANGLE_MEASUREMENTS]	END_PHASE_ANGLE_MEASUREMENTS]
[START_ETCH_DEPTH_MEASUREMENTS	[START_ETCH_DEPTH_MEASUREMENTS
[ETCH_DEPTH_MEASUREMENT_DATE]	[エッチング深さ測定日付]
[ETCH_DEPTH_EQUIP_USED]	[エッチング深さ測定装置]
[ETCH_DEPTH_MODE_USED]	[エッチング深さ測定モード]
[ETCH_DEPTH_MEASUREMENT_FILE_NAME]	[エッチング深さ測定ファイル名]
ETCH_DEPTH_TARGET	指定エッチング深さ
[ETCH_DEPTH_REFERENCE_ONLY]	[エッチング深さ合否判定省略]
[ETCH_DEPTH_TOLERANCE]	[エッチング深さ平均値公差 (MTT)]
[ETCH_DEPTH_RANGE]	[エッチング深さ面内均一性 (レンジ)]
[ETCH_DEPTH_ERROR]	[エッチング深さ公差]
[MEASURED_ETCH_DEPTH_AVERAGE]	[エッチング深さ測定結果 平均値]
[MEASURED_ETCH_DEPTH_TOLERANCE]	[エッチング深さ測定結果 平均値公差]
[MEASURED_ETCH_DEPTH_RANGE]	[エッチング深さ測定結果 レンジ]
[ETCH_DEPTH_MARK_FEATURE]	[エッチング深さ測定マーク]
[ETCH_DEPTH_MARK_LOCATION_DRAWING]	[エッチング深さ測定マーク配置指示書]
[ETCH_DEPTH_MARK_DRAWING]	[エッチング深さ測定マーク指示書]
{MEASURED_ETCH_DEPTH_MARK_SITE_ID	{MEASURED_ETCH_DEPTH_MARK_SITE_ID
[ETCH_DEPTH_MARK_LOCATION]	[エッチング深さ測定マーク配置座標]
MEASURED_ETCH_DEPTH_MARK_LOCATION	MEASURED_ETCH_DEPTH_MARK_LOCATION
MEASURED_ETCH_DEPTH	MEASURED_ETCH_DEPTH
[MEASURED_ETCH_DEPTH_ERROR]	[エッチング深さ測定結果エラー]
END_MEASURED_ETCH_DEPTH_SITE }	END_MEASURED_ETCH_DEPTH_SITE }
END_ETCH_DEPTH_MEASUREMENTS]	END_ETCH_DEPTH_MEASUREMENTS]
[OPERATOR]	[OPERATOR]
END_PHASE_SHIFT_MEASUREMENTS	END_PHASE_SHIFT_MEASUREMENTS
START_REGISTR_MEASUREMENTS	START_REGISTR_MEASUREMENTS
[REGISTR_QUALITY_ID]	[位置精度品質グレード]
{REGISTR_EQUIP_REQD} {EQUIP_SITE_REQD}	{位置測定装置} {装置指定} {位置精度測定手法}
{REGISTR_REF_METHOD_REQD}	
[REGISTR_STD_GRID]	[位置精度基準グリッド] [位置測定アルゴリズム]
[REGISTR_ALGORITHM_TYPE	[REGISTR_ALGORITHM_TYPE
[REGISTR_ALGORITHM_COORDINATES]]	[REGISTR_ALGORITHM_COORDINATES]]

<registr_measurement
s> =

[REGISTR_COMPENSATION_TEMPERATURE]	[位置精度測定補正温度]
[REGISTR_EQUIP_USED] [EQUIP_SITE_USED] [REGISTR_REF_METHOD_USED]	[位置精度測定器] [位置精度測定器指定] [位置精度測定リファレンス方法指定]
[REGISTR_STD_GRID_USED] [REGISTR_ALGORITHM_USED]	[位置精度標準グリッド指定] [位置精度測定アルゴリズム指定]
[REGISTR_MEASUREMENT_DATE]	[位置精度測定日時]
[REGISTR_REF_MASK_ID REGISTR_REF_MASK_SET_ID]	[位置測定リファレンスマスク ID 位置測定リファレンスマスクセット ID]
[REGISTR_ERROR [REGISTR_ERROR_REFERENCE_ONLY]]	[位置精度公差 [位置精度公差(参考用)]]
[REGISTR_SCALE [REGISTR_SCALE_REFERENCE_ONLY]]	[スケール補正許容値 [スケール補正許容値(参考用)]]
[REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE [REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE_REFERENCE_ONLY]]	[REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE [REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE_REFERENCE_ONLY]]
[REGISTR_RESIDUAL [REGISTR_RESIDUAL_REFERENCE_ONLY]]	[残余ばらつき最大許容値 [残余ばらつき最大許容値(参考用)]]
[REGISTR_THREE_SIGMA [REGISTR_THREE_SIGMA_REFERENCE_ONLY]]	[位置精度(3 σ) [位置精度(3 σ)(参考用)]]
[REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA [REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA_REFERENCE_ONLY]]	[残余ばらつき(3 σ) [REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA_REFERENCE_ONLY]]
[REGISTR_TOLERANCE [REGISTR_TOLERANCE_REFERENCE_ONLY]]	[REGISTR_TOLERANCE [REGISTR_TOLERANCE_REFERENCE_ONLY]]
[REGISTR_ORTHO [REGISTR_ORTHO_REFERENCE_ONLY]]	[直交度エラー補正許容値 [直交度エラー補正許容値(参考用)]]
[REGISTR_RELATIVE [REGISTR_RELATIVE_REFERENCE_ONLY]]	[比較測定 [比較測定(参考用)]]
{<measured_registr_mark>}	{<measured_registr_mark>}
[MEASURED_REGISTR_ERROR] [MEASURED_REGISTR_SCALE]	[位置精度測定結果公差エラー] [位置精度測定結果スケール]
[MEASURED_REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE]	[MEASURED_REGISTR_ANISOTROPIC_SCALE]
[MEASURED_REGISTR_THREE_SIGMA]	[位置精度測定結果 3 σ]
[MEASURED_REGISTR_RESIDUAL]	[位置精度測定結果残余ばらつき]
[MEASURED_REGISTR_RESIDUAL_THREE_SIGMA]	[位置精度測定結果残余ばらつき(3 σ)]
[MEASURED_REGISTR_TOLERANCE]	[MEASURED_REGISTR_TOLERANCE]
[MEASURED_REGISTR_MINIMUM] [MEASURED_REGISTR_MAXIMUM]	[位置精度測定結果最小値] [位置精度測定結果最大値]
[MEASURED_REGISTR_ORTHO] [MEASURED_REGISTR_RELATIVE]	[位置精度測定結果直交度] [位置精度測定結果(相対値)]
[MEASURED_REGISTR_FILE_NAME]	[位置精度測定結果ファイル名]
[OPERATOR]	[OPERATOR]
END_REGISTR_MEASUREMENTS	END_REGISTR_MEASUREMENTS
<measured_registr_mark> = START_MEASURED_REGISTR_MARK	START_MEASURED_REGISTR_MARK
MEASURED_REGISTR_MARK_ID	MEASURED_REGISTR_MARK_ID

[VENDOR_REGISTRATION_MARK_ID]	[ベンダー位置精度測定結果マーク ID]
[MASK_REGISTR_MARK_LOCATION]	[マスク位置精度測定結果マーク座標]
MEASURED_REGISTR_MARK_LOCATION	MEASURED_REGISTR_MARK_LOCATION
[MEASURED_REGISTR_MARK_ERROR]	[位置精度測定結果マーク座標エラー]
[MEASURED_REGISTR_MARK_RESIDUAL]	[位置精度測定結果マーク残余エラー]
END_MEASURED_REGISTR_MARK	END_MEASURED_REGISTR_MARK
<closure_measurement_start> =	START_CLOSURE_MEASUREMENTS
{REGISTR_CLOSURE_EQUIP_REQD} {EQUIP_SITE_REQD}	{クロージャ測定装置} {装置指定}
[REGISTR_CLOSURE_EQUIP_USED] [EQUIP_SITE_USED]	[REGISTR_CLOSURE_EQUIP_USED] [EQUIP_SITE_USED]
[REGISTR_CLOSURE]	[クロージャ]
[REGISTR_CLOSURE_REFERENCE_ONLY]	[クロージャ合否判定省略]
MEASURED_REGISTR_CLOSURE	MEASURED_REGISTR_CLOSURE
{ MEASURED_CLOSURE_READING [MEASURED_CLOSURE_LOCATION] }	{クロージャ測定結果表示 [クロージャ測定結果座標] }
[OPERATOR]	[OPERATOR]
END_CLOSURE_MEASUREMENTS	END_CLOSURE_MEASUREMENTS
<cd_group_measurements> =	START_CD_GROUP_MEASUREMENTS
[CD_QUALITY_ID]	[CD 測定品質グレード]
[CD_TONE_CLEAR]	[CD測定白黒]
[CD_MORPHOGRAPHY]	[CD 測定パターン]
[CD_PERCENT_CLEAR] [CD_PERCENT_CLEAR_WINDOW]	[指定エリア開口率] [指定エリア]
[CD_TARGET]	[CD 指定寸法値]
[CD_ORIENTATION]	[CD 測定方向]
[CD_PITCH]	[CD 測定パターンピッチ]
[CD_FEATURE]	[CD 測定パターン形状]
[CD_REFERENCE_ONLY]	[CD 合否判定省略]
[CD_TOLERANCE]	[CD 平均値公差 (MTT)]
[CD_RANGE] [CD_THREE_SIGMA]	[CD 面内均一性 (レンジ)] [CD 面内均一性 (3σ)]
[CD_DEVIATION_FROM_TARGET]	[CD 全点公差 (CD 指定寸法値基準)]
[CD_DEVIATION_FROM_MEAN]	[CD 全点公差 (測定平均値基準)]
[CD_STD] [CD_CORRELATION_ID]	[CD 測定基準] [CD コリレーション ID]
{CD_EQUIP_REQD} {EQUIP_SITE_REQD}	{ CD 測定装置 } {装置指定}
[CD_EQUIP_USED] [EQUIP_SITE_USED]	[CD_EQUIP_USED] [EQUIP_SITE_USED]
[CD_MEASUREMENT_DATE]	[CD_MEASUREMENT_DATE]
[NUMBER_OF_CDS]	[測定点数]
{<cd_measurement>}	{<cd_measurement>}

	[MEASURED_CD_MEAN] [MEASURED_CD_MIN] [MEASURED_CD_MAX]	[CD 測定結果平均値] [CD 測定結果最小値] [CD 測定結果最大値]
	[MEASURED_CD_TOLERANCE]	[CD 測定結果公差]
	[MEASURED_CD_RANGE] [MEASURED_CD_THREE_SIGMA]	[CD 測定結果レンジ] [CD 測定結果 3σ]
	[MEASURED_CD_DEVIATION_FROM_TARGET]	[CD 測定結果の目標からのズレ]
	[MEASURED_CD_DEVIATION_FROM_MEAN]	[CD 測定結果の平均値からのズレ]
	[MEASURED_CD_FILE_NAME]	[CD 測定結果ファイル名]
	[OPERATOR]	[測定者]
	END_CD_GROUP_MEASUREMENTS	END_CD_GROUP_MEASUREMENTS
<cd_measurement> =	START_CD_MEASUREMENT	START_CD_MEASUREMENT
	[[CD_SITE_ID] CD_LOCATION]	[[CD サイト ID] CD 測定座標]
	MEASURED_CD_SITE_ID	MEASURED_CD_SITE_ID
	MEASURED_CD_LOCATION	MEASURED_CD_LOCATION
	MEASURED_CD	MEASURED_CD
	END_CD_MEASUREMENT	END_CD_MEASUREMENT
<cd_set_results> =	START_CD_SET_RESULTS	START_CD_SET_RESULTS
	{CD_GROUP_NAME}	{ CD 測定グループ名}
	[CD_REFERENCE_ONLY]	[CD 合否判定省略]
	[CD_QUALITY_ID]	[CD 測定品質グレード]
	[CD_TOLERANCE] [CD_RANGE] [CD_THREE_SIGMA]	[CD 平均値公差 (MTT)] [CD 面内均一性 (レンジ)] [CD 面内均一性 (3σ)]
	[CD_DEVIATION_FROM_TARGET] [CD_DEVIATION_FROM_MEAN]	[CD 全点公差 (CD 指定寸法値基準)] [CD 全点公差 (測定平均値基準)]
	[MEASURED_CD_MEAN] [MEASURED_CD_MIN] [MEASURED_CD_MAX]	[CD 測定結果平均値] [CD 測定結果最小値] [CD 測定結果最大値]
	[MEASURED_CD_TOLERANCE]	[CD 測定結果公差]
	[MEASURED_CD_RANGE] [MEASURED_CD_THREE_SIGMA]	[CD 測定結果レンジ] [CD 測定結果 3σ]
	[MEASURED_CD_DEVIATION_FROM_TARGET]	[CD 測定結果の目標からのズレ]
	[MEASURED_CD_DEVIATION_FROM_MEAN]	[CD 測定結果の平均値からのズレ]
	END_CD_SET_RESULTS	END_CD_SET_RESULTS
<cd_xy_results> =	START_CD_XY_RESULTS	START_CD_XY_RESULTS
	{CD_X_GROUP} {CD_Y_GROUP}	{CD_X_GROUP} {CD_Y_GROUP}
	{<cd_xy_site>}	{<cd_xy_site>}
	[CD_XY_TOLERANCE] [CD_XY_DEVIATION] [CD_XY_REFERENCE_ONLY]	[CD_XY 寸法平均値公差 (MTT)] [CD_XY 寸法差 (全点)] [CD_XY 寸法差合否判定省略]
	[MEASURED_CD_XY_TOLERANCE] [MEASURED_CD_XY_DEVIATION]	[CD_XY 測定結果公差] [CD_XY 測定結果ズレ]
	[MEASURED_CD_XY_MORPHOGRAPHY]	[MEASURED_CD_XY_MORPHOGRAPHY]
	[MEASURED_CD_XY_TONE_CLEAR]	[MEASURED_CD_XY_TONE_CLEAR]
	END_CD_XY_RESULTS	END_CD_XY_RESULTS
<cd_xy_site> =	START_CD_XY_SITE	START_CD_XY_SITE

[CD_HORIZONTAL_ID CD_HORIZONTAL_LOCATION]	[CD_X 方向測定 ID CD_X 方向測定座標]
[CD_HORIZONTAL_MORPHOGRAPHY] [CD_HORIZONTAL_TONE_CLEAR]	[CD_HORIZONTAL_MORPHOGR APHY] [CD_HORIZONTAL_TONE_CLEAR]
MEASURED_HORIZONTAL_CD	MEASURED_HORIZONTAL_CD
[CD_VERTICAL_ID CD_VERTICAL_LOCATION]	[CD_Y 方向測定 ID CD_Y 方向測定座標]
[CD_VERTICAL_MORPHOGRAPHY] [CD_VERTICAL_TONE_CLEAR]	[CD_VERTICAL_MORPHOGRAP HY] [CD_VERTICAL_TONE_CLEAR]
MEASURED_VERTICAL_CD	MEASURED_VERTICAL_CD
END_CD_XY_SITE	END_CD_XY_SITE
<cd_clear_dark_results START_CD_CLEAR_DARK_RESULTS > =	START_CD_CLEAR_DARK_RESULTS
CD_CLEAR_SET	CD_CLEAR_SET
CD_DARK_SET	CD_DARK_SET
[CD_CLEAR_DARK_TOLERANCE]	[CD_CLEAR_DARK_TOLERANCE]
[CD_CLEAR_DARK_REFERENCE_ONLY]	[CD_CLEAR_DARK_REFERENCE_ONLY]
[MEASURED_CD_CLEAR_SET_MEAN MEASURED_CD_DARK_SET_MEAN]	[MEASURED_CD_CLEAR_SET_MEAN MEASURED_CD_DARK_SET_MEAN]
[MEASURED_CD_CLEAR_SET_TOLERANCE	[MEASURED_CD_CLEAR_SET_TOLERA NCE
MEASURED_CD_DARK_SET_TOLERANCE]	MEASURED_CD_DARK_SET_T OLERANCE]
[MEASURED_CD_CLEAR_DARK_TOLERANCE]	[MEASURED_CD_CLEAR_DARK_TOLER ANCE]
END_CD_CLEAR_DARK_RESULTS	END_CD_CLEAR_DARK_RESULTS
<cd_same_tone_results START_CD_SAME_TONE_RESULTS > =	START_CD_SAME_TONE_RESULTS
CD_SAME_TONE_SET	CD_SAME_TONE_SET
CD_SAME_TONE_SET	CD_SAME_TONE_SET
[CD_SAME_TONE_TOLERANCE]	[CD_SAME_TONE_TOLERANCE]
[CD_SAME_TONE_REFERENCE_ONLY]	[CD_SAME_TONE_REFERENCE_ONLY]
[MEASURED_CD_SAME_TONE_SET_MEAN MEASURED_CD_SAME_TONE_SET_MEAN]	[MEASURED_CD_SAME_TONE_SET_ME AN MEASURED_CD_SAME_TONE_SET_ME AN]
[MEASURED_CD_SAME_TONE_TOLERANCE]	[MEASURED_CD_SAME_TONE_TOLERA NCE]
END_CD_SAME_TONE_RESULTS	END_CD_SAME_TONE_RESULTS
<defect_measurements START_DEFECT_MEASUREMENTS > =	START_DEFECT_MEASUREMENTS
[DEFECT_QUALITY_ID]	[欠陥品質グレード ID]
[INSPECTION_REF_LOCATION]	[欠陥検査リファレンスマーク配置座標]
{INSPECTION_AREA} [INSPECTION_BORDER] {INSPECTION_AREA_EXCLUDE}	{欠陥検査領域指定 }[INSPECTION_BORDER] {欠陥検査除外 領域指定}
{VISUAL_INSP_CRITERIA}	{VISUAL_INSP_CRITERIA}

DIE_TO_DIE_INSPECTION	DD 検査要否
DIE_TO_DIE_MEASUREMENTS	DIE_TO_DIE_MEASUREMENTS
{<defect_measurement_reqd>}	{<defect_measurement_reqd>}
[<defect_measurement_used>]	[<defect_measurement_used>]
[DEFECT_INSP_DATE]	[欠陥検査日時]
{REPAIR_EQUIP_REQD {EQUIP_SITE_REQD} }	{欠陥修正装置指定}
[REPAIR_EQUIP_USED [EQUIP_SITE_USED]]	[欠陥修正使用装置]
{MEASURED_INSPECTION_AREA}	{欠陥検査範囲}
{MEASURED_INSPECTION_AREA_EXCLUDE}	
<defect_measurement_site>	<defect_measurement_site>
[DEFECT_SIZE] [DEFECT_SIZE_CL]	[欠陥許容サイズ(全タイプ)ZE] [白欠陥許容サイズ] [黒欠陥許容サイズ]
[DEFECT_SIZE_DK]	
[DEFECT_SIZE_CL_ADJ]	[非繰返しエッジ白欠陥許容サイズ] [繰返しエッジ白欠陥許容サイズ]
[DEFECT_SIZE_CL_ADJ_REP]	
[DEFECT_SIZE_DK_ADJ]	[非繰返しエッジ黒欠陥許容サイズ] [繰返しエッジ黒欠陥許容サイズ]
[DEFECT_SIZE_DK_ADJ_REP]	
[DEFECT_SIZE_CL_ISO]	[非繰返し孤立白欠陥許容サイズ] [繰返し孤立白欠陥許容サイズ]
[DEFECT_SIZE_CL_ISO_REP]	
[DEFECT_SIZE_DK_ISO]	[非繰返し孤立黒欠陥許容サイズ] [繰返し孤立黒欠陥許容サイズ]
[DEFECT_SIZE_DK_ISO_REP]	
[[DEFECT_DENSITY]	[[1cm 角内欠陥許容数] 検査測定結果 欠陥密度]
MEASURED_DEFECT_DENSITY]	
[[DEFECT_COUNT] MEASURED_DEFECT_COUNT]	[[許容欠陥個数] 検査測定結果 欠陥数]
[[DEFECT_COUNT_REP]	[[許容繰返し欠陥個数] 検査測定結果 繰返し欠陥数]
MEASURED_DEFECT_COUNT_REP]	
[MEASURED_DEFECT_COUNT_WITHIN_SPEC]	[検査測定結果 規格欠陥数]
[[DEFECTIVE_DIE_DENSITY]	[[欠陥ダイ許容欠陥密度] 検査測定結果 ダイ欠陥密度]
MEASURED_DEFECTIVE_DIE_DENSITY]	
[[DEFECTIVE_DIE_COUNT]	[[欠陥許容ダイ数] 検査測定結果 ダイ欠陥密度]
MEASURED_DEFECTIVE_DIE_COUNT]	
[[DEFECTIVE_DIE_COUNT_REP]	[[繰返し欠陥許容ダイ数] 検査測定結果 ダイ繰返し欠陥数]
MEASURED_DEFECTIVE_DIE_COUNT_REP]	
[[PERCENT_DEFECTIVE_DIE]	[[欠陥許容ダイ率] 検査測定結果 欠陥ダイのパーセント]
MEASURED_PERCENT_DEFECTIVE_DIE]	
{MEASURED_DEFECT_FILE_NAME}	{検査測定結果ファイル名}
[PRE_PELL_INSPECTION_ID]	[プリペリクル検査 ID] [プリペリクル検査日時]
[PRE_PELL_INSPECTION_DATE_AND_TIME]	
[POST_PELL_INSPECTION_ID]	[ポストペリクル検査 ID] [ポストペリクル検査日時]
[POST_PELL_INSPECTION_DATE_AND_TIME]	
[OPERATOR]	[測定者]
END_DEFECT_MEASUREMENTS	END_DEFECT_MEASUREMENTS
<defect_measurement_reqd> = DEFECT_EQUIP_REQD {EQUIP_SITE_REQD}	DEFECT_EQUIP_REQD
	{EQUIP_SITE_REQD}
	[DEFECT_INSP_MODE_REQD]
	[DEFECT_INSP_PIXEL_SIZE_REQD]

<pre> {DEFECT_TYPE DEFECT_INSP_SENSITIVITY_REQD{BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_REQD } } [DEFECT_SETUP_FILE_NAME_REQD] </pre>	<pre> {DEFECT_TYPE DEFECT_INSP_SENSITIVITY_REQD{BIN_SI ZE SEVERITY_CRITERION_REQD } } [DEFECT_SETUP_FILE_NAME_REQD] </pre>
<pre> <defect_measurement_use DEFECT_EQUIP_USED [EQUIP_SITE_USED] d> = [DEFECT_INSP_MODE_USED] [DEFECT_INSP_PIXEL_SIZE_USED] {DEFECT_TYPE DEFECT_INSP_SENSITIVITY_USED{BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_USED } } [DEFECT_SETUP_FILE_NAME_USED] </pre>	<pre> DEFECT_EQUIP_USED [EQUIP_SITE_USED] [DEFECT_INSP_MODE_USED] [DEFECT_INSP_PIXEL_SIZE_USED] {DEFECT_TYPE DEFECT_INSP_SENSITIVITY_USED{BIN_SI ZE SEVERITY_CRITERION_USED } } [DEFECT_SETUP_FILE_NAME_USED] </pre>
<pre> <defect_measurement_ START_DEFECT_SITE site> = [DEFECT_TYPE] [DEFECT_TYPE_P22] MEASURED_DEFECT_LOCATION [MEASURED_DEFECT_SIZE] [ADDITIONAL_DEFECT_MEASUREMENTS_INFO] END_DEFECT_SITE </pre>	<pre> START_DEFECT_SITE [許容欠陥タイプ] [許容欠陥タイプ P22] MEASURED_DEFECT_LOCATION [許容欠陥サイズ検査測定] [許容欠陥検査測定結果追加情報] END_DEFECT_SITE </pre>
<pre> <surface_insp_measure START_SURFACE_INSP_MEASUREMENTS ments> = [SURFACE_QUALITY_ID] {<surface_insp_reqd>} [<surface_insp_used>] [MEASURED_DEFECT_COUNT] [MEASURED_DEFECT_COUNT_WITHIN_SPEC] {MEASURED_SURF_INSP_FILE_NAME} [PRE_PELL_INSPECTION_ID] [PRE_PELL_INSPECTION_DATE_AND_TIME] [POST_PELL_INSPECTION_ID] [POST_PELL_INSPECTION_DATE_AND_TIME] [OPERATOR] END_SURFACE_INSP_MEASUREMENTS </pre>	<pre> START_SURFACE_INSP_MEASUREMENTS [異物品質グレード] {<surface_insp_reqd>} [<surface_insp_used>] [異物検査結果数] [異物検査結果規格内数] [異物検査結果ファイル名] [プリベリクル検査 ID] [プリベリクル検査日時] [ポストベリクル検査 ID] [ポストベリクル検査日時] [測定者] END_SURFACE_INSP_MEASUREMENTS </pre>
<pre> <surface_insp_reqd> SURF_INSP_EQUIP_REQD = {EQUIP_SITE_REQD} [SURF_INSP_MODE_REQD] [SURF_INSP_PIXEL_SIZE_REQD] {SURF_DEFECT_TYPE SURF_INSP_SENSITIVITY_REQD {BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_REQD } } [SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_REQD] </pre>	<pre> SURF_INSP_EQUIP_REQD {EQUIP_SITE_REQD} [SURF_INSP_MODE_REQD] [SURF_INSP_PIXEL_SIZE_REQD] {SURF_DEFECT_TYPE SURF_INSP_SENSITIVITY_REQD {BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_REQD } } [SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_REQD] </pre>
<pre> <surface_insp_used> SURF_INSP_EQUIP_USED = [EQUIP_SITE_USED] [SURF_INSP_MODE_USED] [SURF_INSP_PIXEL_SIZE_USED] </pre>	<pre> SURF_INSP_EQUIP_USED [EQUIP_SITE_USED] [SURF_INSP_MODE_USED] [SURF_INSP_PIXEL_SIZE_USED] </pre>

{SURF_DEFECT_TYPE SURF_INSP_SENSITIVITY_USED	{SURF_DEFECT_TYPE SURF_INSP_SENSITIVITY_USED	{SURF_DEFECT_TYPE SURF_INSP_SENSITIVITY_USED
{ BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_USED }}	{	{ BIN_SIZE SEVERITY_CRITERION_USED }}
[SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_USED]	[SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_USED]	[SURF_INSP_SETUP_FILE_NAME_USED]
<contamination_measurements> =	CONTAMINANT CONTAMINATION_LEVEL [CONTAMINATION_METHOD]	CONTAMINANT CONTAMINATION_LEVEL [コンタミネーション方法]
end bnf	maskResults	maskResults

8 用語と用法

8.1 シンタックスキーワード

8.1.1 キーワード名には常に、データフィールドの(括弧で囲まれた)データタイプが続く。データのタイプは、数値(numeric)、整数(integer)、テキスト(text)、ブーリアン(Boolean)、日付(date) (時間を含める場合がある)から成る。(例えば“(テキスト)”)

8.1.2 データフィールドが多数値データフィールドを許容する場合 (§ 7.3 参照), そのデータフィールドには、コンマで区切られ括弧で囲まれたパラメータの順番リストが続く。(例えば、許容できるデータ値を指定する“(x,y)”は、寸法・座標・繰返し回数・ファイル名・または他のパラメータの順序対でなければならない。“(x,y,z)”は三倍順序を指定し、または、“(x1,y1,x2,y2)”は 2 つの順序対のウィンドウを指定し、(x1,y1)と(x2,y2)は左下象限と右上象限を各々表す。)

8.1.3 キーワードのための特定の代替データ値が列挙されている場合、それらは、大括弧(“[]”)で囲まれ、かつ、「パイプ」オペレーター(“|”)で区切られる(例えば “[A | B | C | D | E]”)。これらの数値は、スペリングと大小文字を忠実に変換しなければならない。ブーリアンのデータフィールドは、データ値 [T | F]を含意する。特定の代替値のないデータフィールドは、任意の適切なデータ値をもつ場合がある。

8.1.4 キーワードのために特別に挙げられた代替データ値に加え、ユーザによって選ばれた追加値が許される場合は、リストには省略記号が続く。(例えば、 “[A | B | C | D | E | ...]”のようになる) そのような追加値は、本スタンダードの将来の改訂に含まれるべく、P10 改訂タスクフォースに提出されるべきである。それらはまた、実施される前にマスクサプライヤと議論されるべきである。

8.2 start_dictionary — XML フォーマットの自動翻訳のための辞書の開始を示す区切り文字。

8.3 ADDITIONAL_DEFECT_MEASUREMENTS_INFO — (テキスト)ベンダーが供給する許容欠陥検査に関連する追加情報。

8.4 ADDITIONAL_MASK_INFO — (テキスト)オーダー入力構造以外のところでは指定できないマスクを指定するために必要な情報。マスクベンダー担当者の注意を喚起しなければならない。

8.5 ADDITIONAL_MASK_SET_INFO — (テキスト)オーダー入力構造以外のところでは指定できない全マスクセットを指定するために必要な情報。マスクベンダー担当者の注意を喚起しなければならない。

8.6 ADDITIONAL_MILESTONE_INFO — (テキスト)ベンダーが供給するマスクの状態に関する追加情報。

8.7 ADDITIONAL_PATTERN_INFO — (テキスト)オーダー入力構造以外のところでは指定できないパターンを指定するために必要な情報。マスクベンダー担当者の注意を喚起しなければならない。

8.8 ADDITIONAL_RESULTS_INFO — (テキスト)顧客に提供すべき情報で、<mask_results>構造以外のところでは指定できない情報。顧客担当者の注意を喚起しなければならない。

8.9 ADDITIONAL_SUBSTRATE_INFO — (テキスト)ベンダーが供給する基板使用に関する追加情報。

- 8.10 AIM_CD_DELTA — (数値) 大気中で画像メトロロジーを行うための、類似の非欠陥フィーチャ間の CD 幅偏差割合。フィーチャを横断して、あるいはフィーチャ間の CD 欠陥計測に用いられる。このキーワードが <mask_option> として表される場合、AIM_WAVELENGTH, WAFER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE, WAFER_EXPOSURE_SIGMA APERTURE, WAFER_EXPOSURE_ILLUMINATION もすべて <mask_option> 下に表されなければならない。この場合はマスクのための大気中での画像メトロロジーは要求されず、顧客との合意に基づきマスクメーカーが必要と見なされる場合に必要条件を設定するのみである。
- 8.11 AIM_FLUX_INTENSITY_DELTA — (数値) 大気中で画像メトロロジーを行うための、類似の非欠陥エリア間のディメンショナルエリア偏差割合。コンタクト欠陥とビア欠陥の計測に用いられる。このキーワードが <mask_option> として表される場合、AIM_WAVELENGTH, WAFER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE, WAFER_EXPOSURE_SIGMA APERTURE, WAFER_EXPOSURE_ILLUMINATION もすべて <mask_option> 下に表されなければならない。この場合はマスクのための大気中での画像メトロロジーは要求されず、顧客との合意に基づきマスクメーカーが必要と見なされる場合に必要条件を設定するのみである。
- 8.12 AIM_INTENSITY_VARIATION_DELTA — (数値) 大気中で画像メトロロジーを行うための、類似の非欠陥エリア間の強度偏差割合。端欠陥または単独欠陥の計測に用いられる。このキーワードが <mask_option> として表される場合、AIM_WAVELENGTH, WAFER_EXPOSURE_NUMERICAL_APERTURE, WAFER_EXPOSURE_SIGMA APERTURE, WAFER_EXPOSURE_ILLUMINATION もすべて <mask_option> 下に表されなければならない。この場合はマスクのための大気中での画像メトロロジーは要求されず、顧客との合意に基づきマスクメーカーが必要と見なされる場合に必要条件を設定するのみである。
- 8.13 AIM_WAVELENGTH — (数値) <aerial_image_data> 計測に用いられるためのナノメートルオーダーの波長。AIM_WAVELENGTH は通常、WAFER_EXPOSURE_WAVELENGTH と適合するが、異なる波長で大気中の画像計測が必要な場合は、個別のパラメーターとして供給される。その二つの値は通常同じであるべきであるにもかかわらず、単独 MASK_ID 用の PSM_WAVELENGTH に加えて、このキーワードが表されることもある。
- 8.14 ALL_PATTERNS_APPROVAL_REQD — (ブーリアン) マスクが描画され得る前に、すべてのパターンが認められる必要がある。
- 8.15 ALL_PATTERNS_APPROVED — (日付) すべてのパターンの承認日付が顧客から認められた。
- 8.16 APPROVAL_REQD — (テキスト) これが存在する場合は、顧客が明示的に承認するまで、マスクが描画されるべきではないことを示す。データフィールドは承認されるべき事項の内容を示す。
- 8.17 APPROVAL_GRANTED — (日付) APPROVAL_REQD のために承認日付が顧客から認められた。
- 8.18 ARRAY_CENTER — (数値) (クロム側を上にして) マスクの公称中央に対する円形アレイ限界の (x,y) 中央。
- 8.19 ARRAY_DIAMETER — (数値) パターン・ファイルに適用されるべき円形アレイ限界の直径。
- 8.20 ARRAY_DIAMETER_INCLUSIVE — (ブーリアン) T の場合は、円形アレイ限界内に少なくとも部分的には含まれているダイが、アレイには含まれなければならない。F の場合は、円形アレイ限界内に完全に含まれているダイのみがアレイ内に含まれることができる。
- 8.21 ATTENUATOR — (テキスト) [MoSi | TiNSiN | ZrSi | ...] 組み込まれた減衰位相シフトマスクのために使われる減衰 Mask_Coating。あるいは、顧客とベンダー間で合意された他の材質。他の Mask_Coatings と連動して使用されることもある。
- 8.22 AUTO_INSPECTION_REQD — (ブーリアン) 欠陥に対するマスクの自動検査が必要である。
- 8.23 BARCODE_LOCATION — (数値) (クロム側を上にして) マスクの公称中央に対して、ベンダーが発生させるバーコードの中心を置く (x, y) 位置。
- 8.24 BARCODE_ROTATION — (整数) (0, 90, 180, または 270) (写す前に) バーコードが時計回りに回転する角度。
- 8.25 BARCODE_TEXT — (テキスト) バーコードを作成するためにベンダーによって使用される符号化内容。

- 8.26 **BARCODE_TEXT_REFERENCE_ONLY** — (ブーリアン)T の場合, **BARCODE_TEXT** はバーコードを構築するためにマスクサプライヤーによって使用されないことを示す。バーコードがパターンファイルとして顧客によって供給されるとき, バーコードのテキスト内容を確認する方法を顧客に提供し, <mask_results>で供給するための同じ情報をマスクサプライヤーに提供する。
- 8.27 **BARCODE_TYPE** — (テキスト)[ASM | ASET | CANON | GCA | NIKON_STD | NIKON_CODE39 | UTIX_10 | UTIX_24 | UT_XLS | ...]必要なバーコードを作成するため, ベンダーによって使用されるエンコーディングシステム。
- 8.28 **BILLING_ADDRESS** — (テキスト)請求書を送るためのアドレス。
- 8.29 **BILLING_CONTACT** — (テキスト)請求目的で接触する人の名前。
- 8.30 **BILLING_EMAIL** — (テキスト)BILLING_CONTACT 用のインターネットアドレス。
- 8.31 **BILLING_FAX** — (テキスト)BUSINESS_CONTACT のファクシミリ機器用の電話番号。
- 8.32 **BILLING_PHONE** — (テキスト)BILLING_CONTACT するための電話番号。
- 8.33 **BIN_SIZE** — (数値)SEVERITY_CRITERION_REQD の選別に対する欠陥の大きさ。
- 8.34 **BLANK_BIREFRINGENCE_REQD** — (数値)マスク製造用の基板が, 入射非偏光線を屈折させて二分化した, 対照偏光線間の分離の要求程度(数値)。センチメートル分のナノメートル (nm/cm)として表される。
- 8.35 **BLANK_BIREFRINGENCE_USED** — (数値)マスク製造用の基板が, 入射非偏光線を屈折させて二分化した, 対照偏光線間の分離の計測程度。センチメートル分のナノメートル (nm/cm)として表される。
- 8.36 **BLANK_DATE_OF_MFG** — (日付)マスクブランク業者から納入され, マスク製造用基板が製作された日付。
- 8.37 **BLANK_FLATNESS** — (数値)[0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ...]品質保証領域内の平坦度(SEMI P1 参照)。
- 8.38 **BLANK_FLATNESS_USED** — (数値)マスクブランクサプライヤーが指定, または, マスクベンダーが評価した, 使用マスクブランクの品質保証領域内の平坦度。
- 8.39 **BLANK_GRADE** — (テキスト)マスクブランクベンダーが指定した, 基板の関連欠陥の指示。
- 8.40 **BLANK_INDEX_OF_REFRACTION** — (数値)真空中の任意の波長をもつ光の速度と, マスク製造用基板内の光の速度との比率。
- 8.41 **BLANK_LENGTH** — (数値)マスクブランクスベンダーの指定する, マスク製造用基板の X 軸の値。
- 8.42 **BLANK_LOT** — (テキスト)マスク製造用基板のための, マスクブランクスベンダーが割り当てた製造ロット識別番号。
- 8.43 **BLANK_LOT_REQD** — (テキスト)マスク製造に必要である基板のための, マスクブランクスベンダーが割り当てた製造ロット識別番号。
- 8.44 **BLANK_SIZE** — (テキスト)[2.5/60 | 3/60 | 3.5/60 | 4/60 | 4/90 | 4/250 | 5/60 | 5/90 | 5/250 | 6/90 | 6/120 | 6/150 | 6/250 | 7/120 | 7/150 | 7/250 | 7.25R/150 | 9/120 | 9/350 | 14/120 | 14/190 | 29/1570 | ...]四角形基板の公称の周囲長(インチ)と厚さ幅(ミル)。。例えば7.25R/150 は円形の基板である(2.5/60, 3/60, 3.5/60, 4/60, 4/90, 4/250, 5/60, 5/90, 5/250, 6/90, 6/120, 6/150, 6/250, 7/120, 7/150, 7/250, 7.25R/150 or 9/350)。(SEMI P1 参照。) <mask_results>内の **BLANK_SIZE** は<mask_order>内の値を真似たものに過ぎず, 実際に使用または授受された基板材料を表すものではない。
- 8.45 **BLANK_THICKNESS** — (数値)マスクブランクスベンダーが指定するマスク製造用基板の z 軸の値。
- 8.46 **BLANK_TYPE** — (テキスト)[DFS | MFS | HTE | LTE | ULTE | SFS | DSFS | WC | SL | EUV | POLY | NIL_CUT | E-FORM/ETCHED | SS-MESH]耐久溶融シリカ, 改良溶融シリカ, 高熱膨張品, 低熱膨張品, 極低熱膨張品(SEMI P1 参照)。SFS は合成溶融シリカで一般に「クオーツ」と呼ばれ, 極低熱膨張品である。DSFS は耐